# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-177371

(43)公開日 平成10年(1998) 6月30日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FΙ		
G 0 9 G	3/36		G 0 9 G	3/36	
G02F	1/133	5 0 5	G 0 2 F	1/133	5 0 5
G09F	9/35		G 0 9 F	9/35	

# 審査請求 未請求 請求項の数37 OL (全 32 頁)

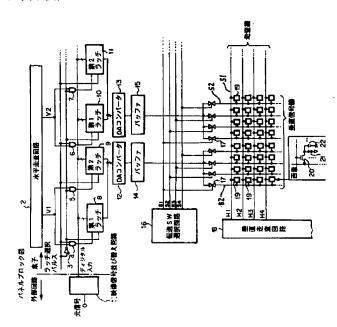
		E Triust	Nichtoff, mission New Arrange of Transfer
(21)出願番号	特顧平9-279013	(71)出願人	000001007
			キヤノン株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)10月13日		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	▲吉▼田 大介
(31)優先権主張番号	特願平8-276531		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
(32)優先日	平 8 (1996)10月18日		ノン株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	山岸 弘一
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(72)発明者	宮脇 守
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(74)代理人	
		(12) (02)(	最終頁に続く
			お父がさらくいこれに、

## (54) 【発明の名称】 マトリクス基板と液晶装置とこれを用いた表示装置

# (57)【要約】

【課題】 液晶素子の駆動回路の部品点数を削減し、1 チップ内に低消費電力でディジタルビデオ信号を高密度 の液晶素子に表示することを課題とする。

【解決手段】 複数の走査線と複数の垂直信号線を有 し、前記走査線と前記垂直信号線の交点にスイッチを介 して画素電極が形成されている液晶装置において、映像 信号がディジタル信号であり映像データを転送する水平 走査回路と、前記水平走査回路の出力に同期して1 画素 分の前記映像データを記憶するデータラッチ回路と、前 記データラッチ回路の出力をアナログ信号に変換するD /Aコンバータと、前記D/Aコンバータの出力に接続 された複数の信号転送スイッチと、前記複数の転送スイ ッチのうち任意の1つを選択する手段とを有することを 特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の走査線と複数の信号線との交点に対応してマトリクス状に設けられた複数のスイッチング素子、前記複数のスイッチング素子に接続された複数の画素電極、前記スイッチング素子に信号を入力するための水平方向回路及び前記複数の走査線を駆動する垂直方向回路とを有するマトリクス基板において、

ディジタル映像信号に基づく映像データをサンプリングする水平走査回路、前記水平走査回路からの出力に同期して前記データを記憶するラッチ回路、前記ラッチ回路からの出力をアナログ信号に変換するD/Aコンバータ、前記D/Aコンバータと前記複数の信号線との間に配された複数の信号転送スイッチ、及び前記複数の信号転送スイッチから少なくとも一つを選択する選択回路とを有することを特徴とするマトリクス基板。

【請求項2】 前記選択回路の出力毎に、前記信号線に前記アナログ信号を前記転送スイッチを介して供給する請求項1に記載のマトリクス基板。

【請求項3】 前記D/Aコンバータの数は、前記水平方向に配されたスイッチング素子の数よりも少なく、一つのD/Aコンバータから、前記水平方向に配された複数のスイッチング素子にアナログ信号が入力される請求項1又は2に記載のマトリクス基板。

【請求項4】 前記選択回路は、シフトレジスタによって構成される請求項1又は2,3に記載のマトリクス基板。

【請求項5】 前記スイッチング素子は、CMOSトランジスタで構成される請求項1乃至4のいずれか1項に記載のマトリクス基板。

【請求項6】 前記映像データと共に信号極性反転信号を入力し、前記信号極性反転信号によって前記D/Aコンバータのアナログ出力の極性を反転させる手段を有する請求項1乃至5のいずれか1項に記載のマトリクス基板。

【請求項7】 前記D/Aコンバータは、前記映像データのビット数よりも1ビット多いビット数の入力が可能であり、前記D/Aコンバータの最上位ビットに前記信号極性反転信号を入力する請求項1乃至6のいずれか1項に記載のマトリクス基板。

【請求項8】 前記D/Aコンバータの出力を切り替え、出力先を少なくとも2つの前記信号転送スイッチ群にふり分けるスイッチを有する請求項1乃至7のいずれか1項に記載のマトリクス基板。

【請求項9】 前記映像データを複数に分割して供給 し、前記水平走査回路によりサンプリングを行う請求項 1 乃至8のいずれか1項に記載のマトリクス基板。

【請求項10】 前記複数に分割された映像データを切り替える手段を有する請求項9に記載のマトリクス基板。

【請求項11】 前記D/Aコンバータの出力を昇圧す

る昇圧回路を有する請求項1乃至10のいずれか1項に 記載のマトリクス基板。

【請求項12】 前記昇圧回路は、クランプ型のアンプからなる請求項11に記載のマトリクス基板。

【請求項13】 前記D/Aコンバータは、上位ビットと下位ビットのデジタル信号をそれぞれデコードして直列に接続した抵抗素子中の一点を選択することにより、アナログ信号を得る請求項1乃至10のいずれか1項に記載のマトリクス基板。

10 【請求項14】 抵抗分割に用いられる前記抵抗素子は、半導体基板中の拡散層を用いて構成され、前記上位ビットの抵抗素子を構成する拡散層の不純物濃度は、前記下位ビットの抵抗素子を構成する拡散層の不純物濃度よりも高いことを特徴とする請求項13に記載のマトリクス基板。

【請求項15】 前記D/Aコンバータは、少なくとも 2つのアナログバッファ回路と、該2つのバッファ回路 のうち1つを選択する回路を有する請求項1乃至14の いずれか1項に記載のマトリクス基板。

20 【請求項16】 前記2つのバッファ回路は、正極性用及び負極性用のものとからなる請求項15に記載のマトリクス基板。

【請求項17】 前記画素電極は、ケミカルメカニカルポリッシングを用いて研磨された請求項1乃至16のいずれか1項に記載のマトリクス基板。

【請求項18】 複数の走査線と複数の信号線との交点に対応してマトリクス状に設けられた複数のスイッチング素子、前記複数のスイッチング素子に接続された複数の画素電極、前記スイッチング素子に信号を入力するための水平方向回路及び前記複数の走査線を駆動する垂直方向回路とを有するマトリクス基板と、前記マトリクス基板に対向する対向基板と、の間に液晶材料を配して構成される液晶装置において、

ディジタル映像信号に基づく映像データをサンプリングする水平走査回路、前記水平走査回路からの出力に同期して前記データを記憶するラッチ回路、前記ラッチ回路からの出力をアナログ信号に変換するD/Aコンバータ、前記D/Aコンバータの出力に接続された複数の信号転送スイッチと、前記複数の信号転送スイッチから少なくとも一つを選択する選択回路とを有することを特徴とする液晶装置。

【請求項19】 前記選択回路の出力毎に、前記信号線に前記アナログ信号を前記転送スイッチを介して供給する請求項18に記載の液晶装置。

【請求項20】 前記 D/A コンバータの数は、前記水平方向に配されたスイッチング素子の数よりも少なく、一つのD/A コンバータから、前記水平方向に配された複数のスイッチング素子にアナログ信号が入力される請求項18又は19に記載の液晶装置。

50 【請求項21】 前記選択回路は、シフトレジスタによ

って構成される請求項18又は19, 20に記載の液晶 装置。

【請求項22】 前記スイッチング素子は、CMOSトランジスタで構成される請求項18乃至21のいずれか1項に記載の液晶装置。

【請求項23】 前記映像データと共に信号極性反転信号を入力し、前記信号極性反転信号によって前記D/Aコンバータのアナログ出力の極性を反転させる手段を有する請求項18乃至22のいずれか1項に記載の液晶装置。

【請求項24】 前記 D/A コンバータは、前記映像データのビット数よりも 1 ビット多いビット数の入力が可能であり、前記 D/A コンバータの最上位ビットに前記信号極性反転信号を入力する請求項 18 乃至 23 のいずれか 1 項に記載の液晶装置。

【請求項25】 前記D/Aコンバータの出力を切り替え、出力先を少なくとも2つの前記信号転送スイッチ群にふり分けるスイッチを有する請求項18乃至24のいずれか1項に記載の液晶装置。

【請求項26】 前記映像データを複数に分割して供給し、前記水平走査回路によりサンプリングを行う請求項25に記載の液晶装置。

【請求項27】 前記複数に分割された映像データを切り替える手段を有する請求項26に記載の液晶装置。

【請求項28】 前記D/Aコンバータの出力を昇圧する昇圧回路を有する請求項18乃至27のいずれか1項に記載の液晶装置。

【請求項29】 前記昇圧回路は、クランプ型のアンプからなる請求項28に記載の液晶装置。

【請求項30】 前記D/Aコンバータは、上位ビットと下位ビットのデジタル信号をそれぞれデコードして直列に接続した抵抗素子中の一点を選択することにより、アナログ信号を得る請求項18乃至29のいずれか1項に記載の液晶装置。

【請求項31】 抵抗分割に用いられる前記抵抗素子は、半導体基板中の拡散層を用いて構成され、前記上位ビットの抵抗素子を構成する拡散層の不純物濃度は、前記下位ビットの抵抗素子を構成する拡散層の不純物濃度よりも高い請求項30に記載の液晶装置。

【請求項32】 前記 D/A コンバータは、少なくとも 2つのアナログバッファ回路と、該2つのバッファ回路 のうち1つを選択する回路を有する請求項18乃至31 のいずれか1項に記載の液晶装置。

【請求項33】 前記2つのバッファ回路は、正極性用及び負極性用のものとからなる請求項32に記載の液晶装置。

【請求項34】 前記画素電極は、ケミカルメカニカルポリッシングを用いて研磨された請求子18乃至33のいずれか1項に記載の液晶装置。

【請求項35】 請求項18乃至34のいずれか1項に

記載の液晶装置を配して構成したことを特徴とする表示 装置。

4

【請求項36】 前記液晶装置として反射型の液晶パネルを用い、光源から発せられた光を該液晶パネルに照射し、反射光を光学系を介してスクリーンに照射して画像を表示する請求項35に記載の表示装置。

【請求項37】 前記反射型の液晶パネルとして、第 1.第2.第3の色画素の3つの色画素のうち第1.第 2の色画素の組み合わせを第1方向に、該第1.第3の 10 色画素の組み合わせを該第1方向と異なる第2方向に該 第1の色画素を共有するように配置した画素ユニットを 基板上に所定のピッチで2次元的に配列した画素ユニットアレイと、該第1方向と第2方向の2つの色画素のピッチを1ピッチとするマイクロレンズを複数個、該基板 上の画素ユニットアレイ上に2次元的に配列したマイクロレンズアレイとを有する液晶パネルを使用する請求項 36に記載の表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

20

【発明の属する技術分野】本発明は、複数の走査線と信号線の交点に画素電極を有するマトリクス基板と、該マトリクス基板と液晶を用いて画像・文字などを表示する液晶装置及びこれを用いた表示装置に関する。特に、液晶素子を駆動する水平・垂直走査回路の内、垂直信号線にビデオ信号を供給する手段に特徴を有するマトリクス基板と、これを用いた液晶装置及びこの液晶装置を用いた表示装置に関する。

# [0002]

【従来の技術】今日、世の中はマルチメディア時代に入30 り、画像情報でコミュニケーションを図る機器の重要性がますます髙まりつつある。なかでも、液晶表示装置は、薄型で消費電力が小さいため注目されており、半導体にならぶ基幹産業にまで成長している。液晶表示装置は、現在、10インチサイズのノートサイズのパソコンに主に使用されている。そして、将来は、パソコンのみでなく、ワークステーションや家庭用のテレビとして、さらに画面サイズの大きい液晶表示装置が使用されると考えられる。しかし、画面サイズの大型化にともない、製造装置が髙価になるばかりでなく、大画面を駆動するためには、電気的に厳しい特性が要求される。このため、画面サイズの大型化とともに、製造コストがサイズの2~3乗に比例するなど急激に増加する。

【0003】そこで、最近、小型の液晶表示パネルを作製し、光学的に液晶画像を拡大して表示するプロジェクション(投影)方式が注目されている。これは、半導体の微細化にともない、性能やコストが良くなるスケーリング則と同様に、サイズを小さくして、特性を向上させ、同時に、低コスト化も図ることができるからである。これらの点から、液晶表示パネルをTFT型としたとき、小型で十分な駆動力を有するTFTが要求され、

5

TFTもアモルファスSiを用いたものから多結晶Siを用いたものに移行しつつある。通常のテレビに使われるNTSC規格などの解像度レベルの映像信号は、あまり高速の処理を必要としない。

【0004】このため、TFTのみでなく、シフトレジ スタもしくはデコーダといった周辺駆動回路まで多結晶 Siで製造して、表示領域と周辺駆動回路が一体構造に なった液晶表示装置ができる。しかし、多結晶Siで も、単結晶Siにはおよばず、NTSC規格より解像度 レベルの大きい高品位テレビや、コンピュータの解像度 規格でいうXGA (eXtended Graphics Array)、SXG A (Super eXtended Graphics Array)クラスの表示を実 現しようとすると、シフトレジスタなどは複数に分割配 置せざるを得ない。この場合、分割のつなぎ目に相当す る表示領域にゴーストと呼ばれるノイズが発生し、その 問題を解決する対策がこの分野では望まれているまた一 方、多結晶Siの一体構造の表示装置より、駆動力が極 めて高い単結晶Si基板を用いる表示装置も注目を集め ている。この場合、周辺駆動回路のトランジスタの駆動 力は申し分ないので、上述したような分割駆動をする必 要はない。このため、表示装置と周辺駆動回路との接続 線間等のS/Nが高くノイズの影響は小さく、ノイズな どの問題は解決できる。

【0005】これらの多結晶Siでも、単結晶Siでも、TFTのドレインと反射電極とを接続して、反射電極と透明な共通電極との間に液晶を挟持して、反射型液晶素子を組み込んだ反射型液晶装置が提供できる。

【0006】また、反射型液晶素子の各画素にビデオ信 号を書き込んで表示させる走査回路も重要であり、その 一例を図40に示して説明する。図40において、ディ ジタル画像信号は信号処理回路230によってD/Aコ ンバートされて、アナログ信号として液晶装置のチップ に入力される。水平走査回路231から出力される制御 信号は転送スイッチ234のゲートに入力され、該制御 信号に応じて共通信号線238上のアナログ信号は、順 次各垂直信号線232に導出される。垂直走査回路23 4は順次走査制御信号を走査線233に出力し、走査線 233は液晶画素内のスイッチMOSトランジスタ23 5のゲートに接続され、そのソースは垂直信号線232 に接続され、スイッチMOSトランジスタ235がオン すれば、垂直信号線232上のビデオ信号は液晶237 にビデオ信号に応じた電界を与えて表示し、所定時間そ の付加容量236に電位を保持して、表示を保持する。

## [0007]

【発明が解決しようとする課題】上記した従来技術には、以下に示す問題点があった。一般に画素への書き込みレートは非常に早く、アナログ信号は非常に高い高周波の信号となる。このため、転送スイッチは高速で転送を完了することが要求され、この高速化により転送スイッチのサイズが大きくなってしまう。また、上記共通信

号線を外部回路と接続するためのパッドまでの配線も必要で、結果的に共通信号線の容量が非常に大きくなる。さらに、液晶表示素子ではアナログ映像信号の振幅は10V以上と非常に高い。このように大きな容量性負荷を大きな振幅で高速に駆動する必要があるため、外部駆動回路として非常に高い能力が要求され、消費電力も大きくなってしまうという問題点があった。その上、外部回路との接続にフレキシブルなケーブル等を用いた場合、そのケーブルの長さに比例してリアクタンス成分が付随するため、共通信号線の負荷容量が大きくなるほど信号のリンギングが大きくなってくる。このため、ケーブルの長さが制限され、機械的な自由度が減少するという問題点もあった。

6

【0008】一方、表示画素数が増した場合に、アクティブマトリクス基板のトランジスタに接続された信号線の駆動速度が遅くなるのに鑑みてなされた発明として、特開平2-216190号公報に開示されたものがある。

【0009】この公報に開示された発明は、信号線駆動用回路素子として、階調情報を持った複数ビットからなる信号を入力信号とすると共に、少なくともコンデンサとスイッチで構成され、複数ビットの信号を時間的に直列に入力するD/A変換器を有るものを用いるというものである。

【0010】これについて図41を用いて説明する。図 41において、1030は、スイッチング素子として薄 膜トランジスタ(不図示)を用いた液晶パネルであり、 これには、駆動回路として信号線駆動回路1040と走 査線駆動回路1050が接続されている。信号線駆動回 路1040は、シフトレジスタ1041、ラッチ104 2、スイッチドキャパシタからなる直列変換型のD/A 変換機群1043、スイッチS1~Snから構成されて いる。ここに示した表示装置においては、1走査電極分 の画像データがシフトレジスタ1041に入力される と、これらの画像データは、7ビット幅の画像データを 保持するラッチ1042に転送され、保持される。つい で、これらの画像データはスイッチトキャパシタ・直列 変換型D/A変換器群1043に入力される。D/A変 換器群1043では、7ビット幅の画像データを各ビッ トずつ順次入力して、7回の変換をすることでデジタル 信号からアナログ信号を出力する。つぎに、アナログ信 号に変換された画像信号は、制御信号に応じてスイッチ S1~Snをオン/オフして1ライン分一括して液晶パ ネル1030に供給され、一時的に液晶パネル1030 内のキャバシタCnに蓄積され、走査線駆動回路105 0からの走査線1032の1ラインずつのオン信号毎 に、信号線1031との交差点に配置するスイッチをオ ンさせて液晶に信号線1031の信号電圧に応じた電界 を加えて液晶表示する。

【0011】ここでは、デジタル信号を入力するため、

D/A変換器が用いられるが、この表示装置において は、D/A変換器がコンデンサ、スイッチ等を用いて構 成されると共に、ビットデータを時間的に直列に入力し てD/A変換を行うため、小さな回路規模で、高精度な D/A変換ができるとされている。

【0012】しかしながら、表示画素数の大きいXG A. SXGA対応等の液晶パネルにおいては、信号線に アナログ信号を入力するために、実際に液晶の表示領域 の周辺部に信号線の数に応じた数のD/A変換器を設け ることは、現実的ではないというのが実状である。

## [0013]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明は、上述 のように種々の問題点を解決するべく、特に近年の映像 信号がディジタル信号として供給される傾向にあること をも考慮に入れて、最適な信号処理と液晶駆動回路とを 提供しようとするものである。

【0014】本発明は、複数の走査線と複数の信号線と の交点に対応してマトリクス状に設けられた複数のスイ ッチング素子、前記複数のスイッチング素子に接続され た複数の画素電極、前記スイッチング素子に信号を入力 するための水平方向回路及び垂直方向回路とを有するマ トリクス基板において、ディジタル映像信号に基づく映 像データをサンプリングする水平走査回路、前記水平走 査回路からの出力に同期して前記データを記憶するラッ チ回路、前記ラッチ回路からの出力をアナログ信号に変 換するD/Aコンバータ、前記D/Aコンバータと前記 複数の信号線との間に配された複数の信号転送スイッ チ、及び前記複数の信号転送スイッチから少なくとも一 つを選択する選択回路とを有することを特徴とするマト リクス基板を提供することにある。

【0015】また、本発明は、複数の走査線と複数の信 号線との交点に対応してマトリクス状に設けられた複数 のスイッチング素子、前記複数のスイッチング素子に接 続された複数の画素電極、前記スイッチング素子に信号 を入力するための水平方向回路及び垂直方向回路とを有 するマトリクス基板と、前記マトリクス基板に対向する 対向基板と、の間に液晶材料を配して構成される液晶装 置において、ディジタル映像信号に基づく映像データを サンプリングする水平走査回路、前記水平走査回路から 記ラッチ回路からの出力をアナログ信号に変換するD/ Aコンバータ、前記D/Aコンバータの出力に接続され た複数の信号転送スイッチと、前記複数の信号転送スイ ッチから少なくとも一つを選択する選択回路とを有する ことを特徴とする液晶装置を提供することにある。

【0016】本発明の液晶装置によれば、外部駆動回路 の部品点数を削減でき、アナログ入力の液晶装置のよう に直接液晶素子をドライブするよりもデジタル入力とす ることで映像信号線の負荷を小さくすることができる。 さらに、D/Aコンバータ1ケ当たりの負荷も小さくで きると共に液晶画素への書き込み時間を長くすることが できるので駆動周波数を低くすることが可能となる。こ れにより液晶装置全体として低消費電力となり、且つ低 消費電力ゆえに髙精細化が容易となる。これに加えてノ イズの影響さえ少なく、高画質化が可能となる。

8

【0017】さらに、本発明によれば、上記反射型の液 晶パネルとして、第1, 第2, 第3の色画素の3つの色 画素のうち第1. 第2の色画素の組み合わせを第1方向 に、該第1, 第3の色画素の組み合わせを該第1方向と 10 異なる第2方向に該第1の色画素を共有するように配置 した画素ユニットを基板上に所定のピッチで2次元的に 配列した画素ユニットアレイと、該第1方向と第2方向 の2つの色画素のピッチを1ピッチとするマイクロレン ズを複数個、該基板上の画素ユニットアレイ上に2次元 的に配列したマイクロレンズアレイとを有する液晶パネ ルを使用することを特徴とする表示装置を提供すること にある。

### [0018]

### 【発明の実施の形態】

[第1の実施形態] 図1は本発明に係る第1の実施形態 を示す等価回路図である。本実施形態では、水平走査回 路2から出力される複数の垂直信号線52と垂直走査回 路18から出力される複数の走査線51を有し、垂直信 号線52と走査線51の交点に画素19内のスイッチを 介して画素電極が形成されている。また走査線51(H 1~H4)…は垂直走査回路(シフトレジスタ)18に 接続されている。さらに、映像信号をデータラッチ回路 8~11…に転送する水平走査回路(シフトレジスタ) 2と、水平走査回路2の出力に同期して映像信号を記憶 30 するデータラッチ回路8~11…と、データラッチ回路 8~11…の出力をアナログの映像信号に変換するD/ Aコンバータ12. 13とを有し、このD/Aコンバー タ12,13の出力が出力バッファ回路14,15と信 号転送スイッチ17を介して垂直信号線52に接続され ている。ここで、出力バッファ回路14、15は、必ず しも設けなくても良い。転送スイッチ17の制御は、例 えばシフトレジスタで構成された転送スイッチ選択回路 16によって行われ、水平走査回路2の動作と同期して 駆動される。これ以外に転送スイッチ選択回路16は、 の出力に同期して前記データを記憶するラッチ回路、前 40 デコーダ回路でも構成することができる。また、3はイ ンバータ、4~7はAND回路、19は液晶素子からな る画素であり、液晶素子の画素19は、スイッチングM 〇Sトランジスタ20と、液晶21と、付加容量22と により1画素を構成している。

> 【0019】本実施形態では、D/Aコンバータ12. 13の数は水平方向の画素数よりも少ない数になってい る。ここでは、D/Aコンバータ12.13の数は水平 方向の画素数の1/4の場合を示している。D/Aコン バータ12, 13の出力はバッファ14, 15を介し て、転送SW選択回路16の出力S1~S4の制御によ

って、それぞれ4個のスイッチ17をオン/オフされ、各液晶素子19に供給される。このため、映像信号は4 画素ずつ飛び越したデータが入力される必要があり、外部の駆動回路として映像信号のデータを画素単位で並べ替える手段1を有し、概念的には図2に示すようにデータを並べ替える必要がある。画素毎の信号に対応した元信号が、時系列的に1~16として入力された場合、映像信号並べ替え回路1の出力は4つ毎に並べ替えられ、下段に示す画素毎の画素番号順となる。

【0020】またD/Aコンバータ12、13の数はパネルサイズ、回路ブロックの面積、D/Aコンバータ12、13の駆動限界周波数、消費電力等を考慮し、設計者が任意に設定できる。本実施形態では1つのD/Aコンバータ12、13にデータラッチ回路8~11が2系統あり、ラッチ選択(セレクト)パルスがインバータ3とAND回路4~7を介されて水平走査回路2の出力V1、V2と論理積をとられることによって、2つのうち任意の1つを選択できる。

【0021】以下、本実施形態の動作について、図3の タイミング図に従い説明する。図3において、まず第1 の水平走査期間にはラッチセレクトパルスをhighと して、水平走査回路2の出力に同期して、ディジタルの 映像データが第1のデータラッチ回路8,10に順次転 送される。次の水平走査期間ではラッチセレクトパルス を10wとして、第2のデータラッチ回路9, 11にデ ータが転送され、同時に第1のデータラッチ回路8.1 0の出力がイネーブル状態となり、出力がD/Aコンバ ータ12, 13に入力され、映像信号をアナログ信号に 変換する。そして転送スイッチ選択手段16によって、 転送スイッチ17のうち1つをオン状態(S1をhig h)とし、このバッファ14を介したアナログ信号を垂 直信号線に転送する。結果的にD/Aコンバータ12. 13の数と同数の液晶画素へ、映像信号書き込みが同時 に行われる。このためD/Aコンバータ12, 13の動 作速度としては、1回の水平走査と同等の期間に応答す ればよい。さらには転送時間が長いため、信号転送スイ ッチ17のサイズも従来のアナログ入力方式に比べ小さ くてすみ、なおかつアナログ入力方式における共通信号 線分の負荷がなく、アナログで駆動すべき負荷が非常に 小さくなる。

【0022】そして第3の水平走査期間では、再び第1のデータラッチ回路にデータを転送し、同時に第2のデータラッチ回路に保持されたデータが画素へ書き込まれる(S2をhigh)。この走査を、繰り返し行い、同時に1つの走査線をオン状態としておき所望の画素に映像信号を書き込み、1ライン分の表示となる。以下全てのラインについて順次同様の書き込みを行い、1画面分の表示となる。

【0023】以上の説明から明らかなように、本発明によれば、D/Aコンバータ1ケにつきデータラッチ回路

を2系統設けていて、データラッチへのディジタル画素 データ転送と信号線へのアナログ画像データ転送をそれ ぞれ水平走査回路と転送スイッチ選択回路で独立に行え るため、タイミング上データの書き込みと読み出しが同 時にできる長所があり、D/Aコンバータの動作周波数 を低くできる。このことは、液晶表示素子の高精細化を 進める上でも非常に有利である。また、D/Aコンバー タを素子に内蔵したことにより、外部の駆動回路の規模 を縮小することができる。一般的にアナログ映像信号の 10 振幅は10 V以上と非常に大きいため、アナログで駆動 する負荷がより小さい方が、消費電力の上で有利であ る。本実施形態では、アナログで駆動する負荷が従来の アナログ入力方式に比べ非常に小さくてすみ、外部駆動 回路を含めた全体での低消費電力化が可能となる。そし て、映像信号の転送は、素子内のD/Aコンバータの直 前までディジタルで行われるため、信号の減衰があって も信号の品質を一定に保たれ、ノイズの影響が少なく、 高画質化が可能である。

【0024】[第2の実施形態] 図4は本発明に係る第2の実施形態を示す等価回路図である。図は、第1の実施形態のD/Aコンバータ部のみを取り出したものであり、映像信号の極性反転を容易に実行できる例を示す。図において、MSBとはアナログ出力の最大値となる基準電圧であり、LSBとはアナログ出力の最小値となる基準電圧である。液晶表示素子では、長時間液晶に直流電圧を印加し続けると、液晶が劣化し、焼き付きが発生する。このため、映像信号を一定周期毎に反転させる交流駆動を行うのが一般的である。本実施形態では、ディジタルの映像信号とは別に信号極性を反転する信号を交流駆動を行うのが一般的である。本実施形態では、ディジタルの映像信号とは別に信号極性を反転する信号を返れる。なおここでは信号極性を反転するために、D/Aコンバータの基準電圧を変化させている。

【0025】以下本実施形態の動作について説明する。 正極性の信号を書き込む期間では、D/Aコンバータの 基準電圧を図4に示したように、INVをhighとし てMSBがVhm、LSBがVhlになり、D/Aコン バータの出力は、Vhm~Vhlのダイナミックレンジ となる。次に負極性の信号を書き込む期間では、D/A コンバータの基準電圧を図4に示したように、INVを lowとしてMSBがVlm、LSBがVllになり、 40 D/Aコンバータの出力は、Vlm~Vllのダイナミ ックレンジとなる。以上により映像信号の極性反転が可 能となる。この極性反転回路を用いることで、ディジタ ルの映像信号とは別に信号極性を反転する信号を液晶表 示素子に与え、これに同期して映像信号の極性を反転さ せて、液晶の劣化を防止し、その焼き付きを簡易に防止 できる。

【0026】[第3実施形態]図5は本発明に係る第3の実施形態を示した等価回路図である。図は、第1の実 50 施形態のD/Aコンバータ部のみを取り出したものであ

る。本実施形態では映像信号のビット数よりも1ビット多いD/Aコンバータによって極性反転を行う。また、INV信号によってディジタル信号を反転させるためのEX-OR(排他的論理和)回路を含んでいる。図5では、映像信号が3ビットであり、D/Aコンバータが4ビットの場合を示している。なおD/Aコンバータのディジタル入力のうち、最上位ビットに極性反転パルスINVを入力し、INVの反転出力が映像信号の3ビットと共にEX-ORに入力され、その出力がD/Aコンバータの下位ビット段に入力されている。また、D/Aコンバータの最大値Vmと最小値V1とが供給されている。

【0027】以下、本実施形態の動作について説明する。INVがhighのときは、D/Aコンバータの出力は図の下段に示したように、Vm~(Vm+V1)/2のダイナミックレンジとなり、INVがlowのときは、D/Aコンバータの出力は図に示したように、(Vm+V1)/2~V1のダイナミックレンジとなる。ここで液晶に加わる電圧は、液晶素子の各画素電極と共って液晶に加わる電圧は、液晶素子の各画素電極と共って液晶に加わる電圧は、液晶素子の各画素電極と対して変化をは映像信号を論理反転する必要があり、INVが10wのときは映像信号を論理反転する必要があり、INVパルスとのEX-ORをとっている。以上により映像信号の極性反転を実現している。本極性反転回路を用いても、第3の実施形態で示した場合と同様に、信号極性を反転する信号を液晶表示素子に与え、これに同期して映像信号の極性を反転させて供給駆動することで、、液晶の劣化を防止し、その焼き付きを簡易に防止できる。

【0028】 [第4の実施形態] 本発明による第4の実 施形態について、上述の液晶駆動回路を含めた液晶パネ ルを用いた液晶表示装置につき、図面を参照しつつ、詳 細に説明する。本発明は、ここに示した形態に限定され るものではない。相互の形態の技術を組み合わせること によって効果が増大することはいうまでもない。また、 液晶パネルの構造は、半導体基板を用いたもので記述し ているが、必ずしも半導体基板に限定されるものはな く、通常の透明基板上に以下に記述する構造体を形成し てもいい。また、以下に記述する液晶パネルは、画素ス イッチがすべてMOSFETやTFTで構成されたもの であるが、画素スイッチは、ダイオード型などの2端子 型であってもいい。さらに、以下に記述する液晶パネル は、家庭用テレビはもちろん、プロジェクタ、ヘッドマ ウントディスプレイ、3次元映像ゲーム機器、ラップト ップコンピュータ、電子手帳、テレビ会議システム、カ ーナビゲーション、飛行機のパネルなどの表示装置とし て有効である。

【0029】本実施形態の液晶パネル部の断面を図6に示す。図において、301は半導体基板、302、302′はそれぞれp型及びn型ウェル、303、303′、303″はトランジスタのソース領域、304はゲート領域、305、305′、305″はドレイン領

域である。

【0030】図6に示すように、表示領域のトランジスタは、20~35 Vという高耐圧が印加されるため、ゲート304に対して、自己整合的にソース、ドレイン層が形成されず、オフセットをもたせ、その間にソース領域303′、ドレイン領域305′に示す如く、pウェル中の低濃度のp 層が設けられる。ちなみにオフセット量は0.5~2.0 $\mu$  mが好適である。一方、周辺回路の一部の回路部が図60 の左側に示されているが、周辺部の一部の回路は、ゲートに自己整合的にソース、ドレイン層が形成されている。

【0031】ここでは、ソース、ドレインのオフセットについて述べたが、それらの有無だけでなく、オフセット量をそれぞれの耐圧に応じて変化させたり、ゲート長の最適化が有効である。これは、周辺回路の一部は、ロジック系回路であり、この部分は、一般に1.5~5V系駆動でよいため、トランジスタサイズの縮小及び、トランジスタの駆動力向上のため、上記自己整合構造が設けられている。本基板301は、p型半導体からなり、基板は、最低電位(通常は、接地電位)であり、n型ウェルは、表示領域の場合、画素に印加する電圧すなわち20~35Vがかかり、一方、周辺回路のロジック部は、ロジック駆動電圧1.5~5Vが印加される。この構造により、それぞれ電圧に応じた最適なデバイスを構成でき、チップサイズの縮小のみならず、駆動スピードの向上による高画素表示が実現可能になる。

【0032】また、図6において、306はフィールド 酸化膜、310はデータ配線につながるソース電極、3 11は画素電極につながるドレイン電極、312は反射 鏡を兼ねる画素電極、307は表示領域、周辺領域を覆 う遮光層で、Ti, TiN, W, Mo等が適している。 図6に示すように、上記遮光層307は、表示領域で は、画素電極312とドレイン電極311との接続部を 除いて覆われているが、周辺画素領域では、一部ビデオ 線、クロック線等、配線容量が重くなる領域は、上記遮 光層307をのぞき、高速信号が上記遮光層307がの ぞかれた部分は照明光の光が混入し、回路の誤動作を起 こす場合は画素電極312の層をおおう設計になってい る転送可能な工夫がなされている。308は遮光層30 7の下部の絶縁層で、P-SiO層318上にSOGに より平坦化処理を施し、そのP-SiO層318をさら に、P-SiO層308でカバーし、絶縁層308の安 定性を確保した。SOGによる平坦化以外に、P-TE OS (Phospho-Tetraetoxy-Silane)膜を形成し、さらに P-SiO層318をカバーした後、絶縁層308をC MP処理し、平坦化する方法を用いても良い事は言うま でもない。

【0033】また、309は反射電極312と遮光層3 50 07との間に設けられた絶縁層で、この絶縁層309を 介して反射電極312の電荷保持容量となっている。大容量形成のために、 $SiO_2$  以外に、高誘電率のP-S iN、 $Ta_2O_5$ 、や $SiO_2$  との積層膜等が有効である。遮光層307にTi、TiN, Mo、W等の平坦なメタル上に設ける事により、 $500\sim500$  のオングストローム程度の膜厚が好適である。

【0034】さらに、314は液晶材料、315は共通透明電極、316は対向基板、317,317′は高濃度不純物領域、319は表示領域、320は反射防止膜である

【0035】図6に示すように、トランジスタ下部に形成されたウェル302,302 と同一極性の高濃度不純物層317,317 は、ウェル302,302 の周辺部及び内容に形成されており、高振幅な信号がソースに印加されても、ウェル電位は、低抵抗層で所望の電位に固定されているため、安定しており、高品質な画像表示が実現できた。さらにn型ウェル302 とp型ウェル302との間には、フィールド酸化膜を介して上記高濃度不純物層317,317 が設けられており、通常MOSトランジスタの時に使用されるフィールド酸化度直下のチャネルストップ層を不要にしている。

【0036】これらの高濃度不純物層317,317′は、ソース、ドレイン層形成プロセスで同時にできるので作製プロセスにおけるマスク枚数、工数が削減され、低コスト化が図れた。

【0037】次に、313は共通透明電極315と対向基板316との間に設けられた反射防止用膜で、界面の液晶の屈折率を考慮して、界面反射率が軽減されるように構成される。その場合、対向基板316と、透過電極315の屈折率よりも小さい絶縁膜が好適である。

【0038】次に、本実施形態の回路図を図7に示す。 図7においては、垂直信号線に信号を供給する水平方向 走査回路は、図1に示されたものと同様のものが用いら れているが、図1との違いは、DAコンバータ12から 出力されるアナログ信号が、バッファ回路を通らずに、 信号転送スイッチ17に供給される点である。その他に ついては、図1に示したものと同様であるので、ここで は、DAコンバータ12、転送スイッチ選択回路16、 信号転送スイッチ17、以外は省略した。また、322 は垂直シフトレジスタ(VSR)、323はnチャンネ ルMOSFET、324はpチャンネルMOSFET、 325は保持容量、326は液晶層、327は信号転送 スイッチ、328はリセットスイッチ、329はリセッ トパルス入力端子、330はリセット電源端子、331 は映像信号の入力端子である。また、319は表示領域 を示している。また半導体基板301は図6ではp型に なっているが、n型でもよい。

【0039】図6に示すように、ウェル領域302 は、半導体基板301と反対の導電型にする。このため、図6では、ウェル領域302はp型になっている。

p型のウェル領域302及びn型のウェル領域302<sup>°</sup> は、半導体基板301よりも高濃度に不純物が注入され ていることが望ましく、半導体基板301の不純物濃度 が $10^{14}$ ~ $10^{15}$  (cm<sup>-3</sup>) のとき、ウェル領域302の不純物濃度は $10^{15}$ ~ $10^{17}$  (cm<sup>-3</sup>) が望ましい。 【0040】ソース電極310は、表示用信号が送られ てくるデータ配線に、ドレイン電極311は画素電極3 12に接続する。これらの電極310,311には、通 常Al, AlSi, AlSiCu, AlGeCu, Al 10 Cu配線を用いる。これらの電極310,311の下部 と半導体との接触面に、TiとTiNからなるバイアメ タル層を用いると、コンタクトが安定に実現できる。ま たコンタクト抵抗も低減できる。画素電極312は、表 面が平坦で、高反射材が望ましく、通常の配線用金属で あるAl. AlSi, AlSiCu, AlGeCu, A 1 C以外にCr. Au. Agなどの材料を使用すること が可能である。また、平坦性の向上のため、下地絶縁層 309や画素電極312の表面をケミカルメカニカルポ リッシング(CMP)法によって処理している。

14

20 【0041】図7に示す保持容量325は、画素電極3 12と共通透明電極315の間の信号を保持するための容量である。ウェル領域302には、基板電位を印加する。本実施形態では、各行のトランスミッションゲート構成を、上から1行目は上がnチャンネルMOSFET324、2行目は上がpチャンネルMOSFET324で、下がnチャンネルMOSFET323とするように、隣り合う行で順序を入れ換える構成にしている。以上のように、ストライプ型ウェルで表示領域の周辺で電源線とコンタク 30 トしているだけでなく、表示領域にも、細い電源ラインを設けコンタクトをとっている。

【0042】この時、ウェルの抵抗の安定化がカギになる。したがって、p型基板であれば、nウェルの表示領域内部でのコンタクト面積又はコンタクト数をpウェルのコンタクトより増強する構成を採用した。pウェルは、p型基板で一定電位がとられているため、基板が低抵抗体としての役割を演ずる。したがって、島状になるnウェルのソース、ドレインへの信号の入出力による振られの影響が大きくなりやすいが、それを上部の配線層からのコンタクトを増強することで防止できた。これにより、安定した高品位な表示が実現できた。

【0043】映像信号は、図1に示したのと同様にして垂直信号線に供給される。垂直シフトレジスタ322からは、選択した行のn チャンネルMOSFET323のゲートへはハイパルス、p チャンネルMOSFETのゲートへはローパルスを印加する。

【0044】以上のように、画素部のスイッチは、単結晶のCMOSトランスミッションゲートで構成されており、画素電極へ書き込む信号が、MOSFETのしきい 50 値に依存せず、ソースの信号をフルに書き込める利点を 有する。

【0045】又、スイッチが、単結晶トランジスタから 成り立っており、 polysilicon-TFTの結晶粒界での 不安定な振まい等がなく、バラツキのない高信頼性な高 速駆動が実現できる。

【0046】次に、ビデオ信号と、サンプリングパルス の同期を正確にとる方向について図8を用いて説明す る。このためには、サンプリングパルスのdelay量 を変化させる必要がある。342はパルスdelay用 インバータ、343はどのdelay用インバータを選 択するかを決めるスイッチ、344はdelay量が制 御された出力、345は容量であり、出力344のう ち、outBは入力位相に対して逆相出力、outは同 相出力である。また、346は保護回路である。

[0047] SEL1 (SEL1B) からSEL3 (S EL3B) の組み合わせにより、delay用インバー タ342を何個通過するかを選択でき、選択によって遅 延時間を調節できる。

【0048】この同期回路がパネルに内蔵していること により、パネル外部からのパルスのdelay量が、 R. G. B3板パネルのとき、治具等の関係で対称性が くずれても、上記選択スイッチで調整でき、R.G.B のパルス位相高域による位置ずれがない良好な表示画像 が得られた。又、パネル内部に温度測定ダイオードを内 蔵させ、その出力によりdelay量をテーブルから参 照し温度補正することも有効である事は言うまでもな

【0049】次に、液晶材との関係について説明する。 図6では、平坦な対向基板構造のものを示したが、共通 電極基板316は、共通透明電極315の界面反射を防 ぐため、凹凸を形成し、その表面に共通透明電極315 を設けている。また、共通電極基板316の反対側に は、反射防止膜320を設けている。これらの凹凸形状 の形成のために、微少な粒径の砥粒により砂ずり研磨を おこなう方式も高コントラスト化に有効である。

【0050】液晶材料としては、ポリマー・ネットワー ク液晶PNLCを用いた。ただし、ポリマー・ネットワ ーク液晶として、PDLCなどを用いてもいい。ポリマ ー・ネットワーク液晶PNLCは、重合相分離法によっ て作製される。液晶と重合性モノマーやオリゴマーで溶 液をつくり、通常の方法でセル中に注入した後、UV重 合によって液晶と高分子を相分離させ、液晶中に網目状 に高分子を形成する。PNLCは多くの液晶(70~9 Owt%)を含有している。

【0051】PNLCにおいては、屈折率の異方性(△ n)の高いネマチック液晶を用いると光散乱が強くな い、誘電異方性(Δε)の大きいネマチック液晶を用い ると低電圧で駆動が可能となる。ポリマー・ネットワー クのおおきさ、すなわち網目の中心間距離が1~1.5

分強くなる。

【0052】次に、シール構造と、パネル構造との関係 について、図9を用いて説明する。図9において、35 1はシール部、352は電極パッド、353はクロック バッファー回路であり、不図示のアンプ部がある。この アンプ部は、パネル電気検査時の出力アンプとして使用 するものである。また対向基板の電位をとる不図示のA gペースト部があり、また356は液晶素子による表示 部、357は水平・垂直シフトレジスタ (SR) 等の周 10 辺回路部である。シール部351は表示部356の四方 周辺に半導体基板301上に画素電極312を設けたも のと共通電極315を備えたガラス基板との張り合わせ のための圧着材や接着剤の接触領域を示し、シール部3 51で張り合わせた後に、表示部356とシフトレジス 夕部357に液晶を封入する。

16

【0053】図9に示すように、本実施形態では、シー ルの内部にも、外部にも、total chip size が小さくな るように、回路が設けられている。本実施形態では、パ ッドの引き出しをパネルの片辺側の1つに集中させてい 20 るが、長辺側の両辺でも又、一辺でなく多辺からのとり 出しも可能で、高速クロックをとり扱うときに有効であ

【0054】さらに、本実施形態では、Si基板等の半 導体基板を用いているため、プロジェクタのように強力 な光が照射され、基板の側壁にも光があたると、基板電 位が変動し、パネルの誤動作を引き起こす可能性があ る。したがって、パネルの側壁及び、パネル上面の表示 領域の周辺回路部は、遮光できる基板ホルダーとなって おり、又、Si基板の裏面は、熱伝導率の高い接着剤を 30 介して熱伝導率の高いCu等のメタルが接続されたホル ダー構造となっている。

【0055】次に、上述の反射電極構造及びその作製方 法について述べる。本実施形態の完全平坦化反射電極構 造は、メタルをパターニングしてから、研磨する通常の 方法とは異なり、電極パターンのところにあらかじめ、 溝のエッチングをしておき、そこにメタルを成膜し、電 極パターンが成形されない領域上のメタルを研磨でとり 除くとともに、電極パターン上のメタルも平坦化する方 法である。しかも、配線の幅が配線以外の領域よりも極 40 めて広く、従来のエッチング装置の常識では、下記問題 が発生し、本実施形態の構造体は作製できない。

【0056】つまり、エッチングすると、エッチング中 にポリマーが堆積し、パターニングができなくなるので ある。このポリマーはレジストがスパッタされたりエッ チング材料によったり、ガスそのもの等から生成される と思われる。

【0057】そこで、酸化膜系エッチング(CF4/C HF3系)において、条件を変えてみた。その結果を図 10に示す。図10 (a) はtotal圧力が1.7to  $(\mu m)$  の場合、光散乱は高コントラストを得るのに十 50 rr時の特性図、図10(b)はtotal圧力が1.0

torr時の特性図である。

【0058】図10(a)の条件で、デポジション性のガス $CHF_3$ をへらすと、たしかにポリマーの堆積は、減少するが、レジストに近いパターンと遠いパターンでの寸法の違い(ローティング効果)がきわめて大きくなり、使用できない事がわかる。

【0059】本発明者は、実験を重ねた結果、ローティング効果をおさえるため、徐々に圧力を下げていくと、1 torr以下になるとローティング効果がかなり抑制され、かつデポジション性のガス $CHF_3$  をゼロにし、 $CF_4$  のみによるエッチングが有効であることを見出した。

【0060】さらに、画素電極領域は、ほとんどレジストが存在せず、周辺部にはレジストでしめられている。このような構造体を形成するのは難しく、構造として、画素電極と同等の周辺領域の空き電極とその形状を表示領域の周辺部まで設けることが有効であることがわかった。

【0061】本構造にすることにより、従来あった表示 部と周辺部もしくはシール部との段差もなくなり、ギャップ精度が高くなり、面内均一性が高くなるだけでな く、液晶の注入時のムラもへり、高品位の画質が歩留り よくできる効果が得られた。

【0062】次に、本実施形態の反射型液晶パネルを組み込む光学システムについて、図11を用いて説明する。図11において、371はハロゲンランプ等の光源、372は光源像をしぼり込む集光レンズ、373、375は平面状の凸型フレネルレンズ、374はR、G、Bに分解する色分解光学素子で、ダイクロイックミラー、回折格子等が有効である。

【0063】また、376はR, G, B光に分離された それぞれの光をR、G、B3パネルに導くそれぞれのミ ラー、377は集光ビームを反射型液晶パネルに平行光 で照明するための視野レンズ、378は上述の反射型液 晶素子、379の位置にしぼりがある。また、380は 複数のレンズを組み合わせて拡大する投射レンズ、38 1はスクリーンで、通常、投射光を平行光へ変換するフ レネルレンズと上下、左右に広視野角として表示するレ ンチキュラレンズの2板より構成されると明瞭な高コン トラストで明るい画像を得ることができる。図11の構 成では、1色のパネルのみ記載されているが、色分解光 学素子374からしぼり部379の間は3色それぞれに 分離されており、3板パネルが配置されている。又、反 射型液晶装置パネル表面にマイクロレンズアレーを設 け、異なる入射光を異なる画素領域に照射させる配置を とることにより、3板のみならず、単板構成でも可能で あることは言うまでもない。液晶素子の液晶層に電圧が 印加され、各画素で正反射した光は、379に示すしぼ り部を透過しスクリーン上に投射される。

【0064】一方、電圧が印加されずに、液晶層が散乱

体となっている時、反射型液晶素子へ入射した光は、等方的に散乱し、379に示す絞り部の開口を見込む角度の中の散乱光以外は、投射レンズにはいらない。これにより黒を表示する。以上の光学系からわかるように、偏光板が不要で、しかも画素電極の全面が信号光が高反射率で投射レンズにはいるため、従来よりも2-3倍明るい表示が実現できた。上述の実施形態でも述べたように、対向基板表面、界面には、反射防止対策が施されており、ノイズ光成分も極めて少なく、高コントラスト表10 示が実現できた。又、パネルサイズが小さくできるため、すべての光学素子(レンズ、ミラーetc.)が小型化され、低コスト、軽量化が達成された。

18

【0065】又、光源の色ムラ、輝度ムラ、変動は、光源と光学系との間にインテグレタ(はえの目レンズ型ロッド型)を挿入することにより、スクリーン上での色ムラ、輝度ムラは、解決できた。

【0066】上記液晶パネル以外の周辺電気回路につい て、図12を用いて説明する。図において、385は電 源で、主にランプ用電源とパネルや信号処理回路駆動用 20 システム電源に分離される。386はプラグ、387は ランプ温度検出器で、ランプの温度の異常があれば、制 御ボード388によりランプを停止させる等の制御を行 う。これは、ランプに限らず、389のフィルタ安全ス イッチでも同様に制御される。たとえば、髙温ランプハ ウスボックスを開けようとした場合、ボックスがあかな くなるような安全上の対策が施されている。390はス ピーカー、391は音声ボードで、要求に応じて3Dサ ウンド、サラウンドサウンド等のプロセッサも内蔵でき る。392は拡張ボード1で、ビデオ信号用S端子、ビ 30 デオ信号用コンポジット映像、音声等の外部装置396 からの入力端子及びどの信号を選択するかの選択スイッ チ395、チューナ394からなり、デコーダ393を 介して拡張ボード2へ信号が送られる。一方、拡張ボー ド2は、おもに、別系列からのビデオやコンピュータの Dsub 15ピン端子を有し、デコーダ393からのビデ オ信号と切り換えるスイッチ450を介して、A/Dコ ンバータ451でディジタル信号に変換される。

【0067】また、453は主にビデオRAM等のメモリとCPUとからなるメインボードである。A/Dコンバータ451でA/D変換したNTSC信号は、一端メモリに蓄積され、高画素数へうまく割りあてるために、液晶素子数にマッチしていない空き素子の不足の信号を補間して作成したり、液晶表示素子に適したγ変換エッジ階調、ブライト調整バイアス調整等の信号処理を行う。NTSC信号でなく、コンピュータ信号も、たとえばVGAの信号がくれば、高解像度のXGAパネルの場合、その解像度変換処理も行う。一画像データだけでなく、複数の画像データのNTSC信号にコンピュータ信号を合成させる等の処理もこのメインボード453で行

(11)

20

【0068】メインボード453の出力はパラレル/シリアル変換され、ノイズの影響を受けにくい形態でヘッドボード454に充られる。このヘッドボード454で、再度シリアル/パラレル変換後、B、G、R色の液晶パネル455、456、457へ信号を書き込む。452はリモコン操作パネルで、コンピュータ画面も、TVと同様の感覚で、簡単操作可能となっている。また、液晶パネル455、456、457の夫々は、各色の水で、カイン・垂直走査回路は第1~第5実施形態で説明したものを適用する。各液晶装置は以上の説明のように、必ずしも高解像度がない画像も処理により高品位画像化になるため、本実施形態では、きわめてきれいな画像表示が可能である。

【0069】本発明においては、液晶装置の画素電極をケミカルメカニカルポリッシング(CMP: Chemical Mechanical Polishing)を用いて研磨することも可能である。ケミカルメカニカルポリッシングを用いると画素電極が極めて平坦(鏡面)に仕上がるので都合が良い。本発明においては、先に本出願人が出願した特願平8-178711号に開示した技術を適用することができる。特願平8-178711号出願は、以下の不都合に鑑みてなされたものである。即ち、液晶画素の画素電極に光が入射すると、表面の凹凸によって入射光が四方八方に散乱され、光の反射効率が非常に小さくなる。この表面凹凸は液晶実装工程の配向膜ラビング工程において、配向不良の原因となる。その結果、液晶の配向不良を引き起こし、コントラストの低下により表示画像の画質が悪化する。

【0070】また、各画素電極間の溝の部分はラビングされないため、液晶配向不良の原因になると同時に、表面凹凸と相俟って、画素電極間の横方向電界を発生し、 輝線の原因となる。この輝線の発生は、表示画像のコントラストを悪化させる。

【0071】上記の出願は、ケミカルメカニカルポリッシング(Chemical Mechanical Polishing)により、画素電極表面を研磨するというものでこれによると該画素電極表面が鏡面状に平滑に形成されると同時に、全画素電極表面を同一平面に形成することができる。さらに、絶縁層を形成した上に画素電極層を形成、或いは、ホールを形成した画素電極層上に絶縁層を成膜し、上記研磨工程を行なうことにより、画素電極間が絶縁層により良好に埋められ、完全に凹凸がなくなる。よって、該凹凸によって生じた乱反射や配向不良が防止され、高画質な画像表示が可能となる。

【0072】図13及び図14を用いてこの技術について説明する。図13及び図14は、反射型の液晶装置に適用されるアクティブマトリクス基板の画素部を示しているが、画素部形成工程と同時に、画素部のスイッチングトランジスタを駆動するためのシフトレジスタ等周辺 50

駆動回路も同一基板上に形成することができる。 【0073】以下、順を追って製造プロセスについて

【0073】以下、順を追って製造プロセスについて説明する。

【0074】不純物濃度が $10^{15}$ cm $^{-3}$ 以下であるn形シリコン半導体基板201を部分熱酸化し、LOCOS 202を形成し、該LOCOS 202をマスクとしてボロンをドーズ量 $10^{12}$ cm $^{-2}$ 程度イオン注入し、不純物濃度 $10^{16}$ cm $^{-3}$ 程度のp形不純物領域であるPWL2 03を形成する。この基板201を再度熱酸化し、酸化膜厚1000オングストローム以下のゲート酸化膜204を形成する(図13(a))。

【0075】リンを $10^{20}$ cm $^{-3}$ 程度ドープしたn形ポリシリコンからなるゲート電極205を形成した後、基板201全面にリンをドーズ量 $10^{12}$ cm $^{-2}$ 程度イオン注入し、不純物濃度 $10^{16}$ cm $^{-3}$ 程度のn形不純物領域であるNLD206を形成し、引き続き、パターニングされたフォトレジストをマスクとして、リンをドーズ量 $10^{15}$ cm $^{-2}$ 程度イオン注入し、不純物濃度 $10^{19}$ cm $^{-3}$ 程度のソース、ドレイン領域207,207'を形成のする(図13(b))。

【0076】基板201全面に層間膜であるPSG208を形成する。このPSG208はNSG(Nondope Silicate Glass)/BPSG(Boro-Phospho-Silicate Glass)や、TEOS(Tetraetoxy-Silane)で代替することも可能である。ソース、ドレイン領域207、207′の直上のPSG208にコンタクトホールをパターニングし、スパッタリングによりAlを蒸着した後パターニングし、Al電極209を形成する(図13(c))。このAl電極209と、ソース、ドレイン領域207、207′とのオーミックコンタクト特性を向上させるために、Ti/TiN等のバリアメタルを、Al電極209とソース、ドレイン領域207、207′との間に形成するのが望ましい。

【0077】基板201全面にプラズマSiN210を3000オングストローム程度、続いてPSG211を10000オングストローム程度成膜する(図13(d))。

【0078】プラズマSiN210をドライエッチングストッパー層として、PSG211を画素間の分離領域のみを残すようにパターニングし、その後ドレイン領域207′にコンタクトしているA1電極209直上にスルーホール212をドライエッチングによりパターニングする(図13(e))。

【0079】基板201上にスパッタリング、或いはEB(Electron Beam、電子線)蒸着により、画素電極213を10000オングストローム以上成膜する(図14(f))。この画素電極213としては、Al. Ti. Ta. W等の金属膜、或いはこれら金属の化合物膜を用いる。

【0080】画素電極213の表面をCMPにより研磨

する (図14 (g))。研磨量はPSG211厚を10 000オングストローム、画素電極厚をxオングストロ ームとした場合、xオングストローム以上、x+100 00オングストローム未満である。

【0081】上記の工程により形成されたアクティブマ トリクス基板はその表面にさらに配向膜215を形成 し、その表面にラビング処理等配向処理を施し、スペー サ(不図示)を介して対向基板と貼り合わせ、その間隙 に液晶214を注入して液晶素子とする(図14

(h))。本実施形態においては、対向基板は透明基板 220上にカラーフィルター221、ブラックマトリク ス222、ITO等からなる共通電極223、及び配向 膜215′から構成されている。

【0082】本実施形態のアクティブマトリクス基板 は、図14(h)から明らかなように、画素電極213 表面が平滑であり、且つ、隣接する画素電極間間隙に絶 縁層が埋め込まれているため、その上に形成される配向 膜215表面も平滑で凹凸がない。よって、この技術を 適用すると画素電極上の凹凸によって生じていた、入射 光の散乱により光利用効率の低下、ラビング不良による コントラストの低下、画素電極間の段差による横方向電 界による輝線の発生が防止され、表示画像の品質向上が 図れる。

【0083】 [第5の実施形態] 本発明の第5の実施形 態について、図15を用いて詳細に説明する。図15に 示した例は、図1に示した例に類似する形態であるが、 図1に示したものとの最も大きな違いは、D/Aコンバ ータ12と信号転送スイッチ17との間にD/Aコンバ ータ12の出力を切り替える手段53 (スイッチ) が設 けられていることである。なお、ここで、バッファアン プ14は、必ずしも設けなくとも良い。図15におい て、図1に示されるのと同一の部位には同じ番号を付し たので各部についての詳しい説明は省略する。

【0084】図15に示した例においては、ディジタル 映像信号は水平走査回路2の出力に同期して、一旦デー タラッチ回路8に記憶される。次いでこのディジタル信 号はD/Aコンバータ12によってアナログ信号に変換 された後、アナログ信号はD/Aコンバータ12の出力 を切り替える手段53によって、出力先を2つの転送ス 択手段16によって転送スイッチ17を選択的にオン状 態とし、転送スイッチ17を介して垂直信号線52にア ナログ映像信号が供給される。そして垂直走査回路18 によって所定の走査線51を選択することで、画素へ映 像信号を書き込む。これにより画像表示が可能となる。

【0085】一般にD/Aコンバータ12やバッファア ンプ14の特性は個体毎に特性が少なからず異なる。す ると同じD/Aコンバータ12から映像信号を書き込む 画素ブロック毎、例えば図1に示した例では4画素毎 に、輝度差を生じる可能性がある。そこで本実施形態で は、D/Aコンバータ12の出力を切り替える手段53 を用いて、同一画素が必ずしも同じD/Aコンバータ1 2によって書き込まれないようにした。こうすることに よって画素ブロック毎、本実施形態では4画素毎の輝度 差を小さくでき、更に高品位の表示が可能になる。

【0086】次いで図16に示した例について説明す る。図16と図15との違いは、図16においては、デ ィジタルの映像信号を複数に分割して入力する構成にな っている点、及び映像信号を切り替える(マルチプレッ クス)手段55を有している点である。図16に示した 10 例においては、D/Aコンバータの出力を切り替えたと きに、映像信号が所定の表示画素に書き込まれなくなる のを防ぐために、映像信号をマルチプレックス回路55 によって入れ替えて所望の画素に書き込めるようにして

【0087】図15及び図16に示した例においては、 D/Aコンバータに特性のばらつきがある場合であって も極めて高品位な画像を表示できる。

【0088】 [第6の実施形態] 本発明の第6の実施形 態について、図17を用いて詳細に説明する。図17に 示した例は、図1に示した例に類似するものであるが、 図1に示したものと最も大きな違いは、D/Aコンバー タ12と信号転送スイッチ17との間に、D/Aコンバ ータ12の出力を昇圧する昇圧回路60が設けられてい る点である。図17においても、図1に示されるのと同 一の部位には同じ番号を付しているので各部についての 詳しい説明は省略する。

【0089】図17に示した例においては、ディジタル 映像信号は水平走査回路2の出力に同期して、一旦デー タラッチ回路8に記憶される。次いでこのディジタル信 号はD/Aコンバータ12によってアナログ信号に変換 された後、昇圧回路60によって所定の振幅に変化させ られる。さらに転送スイッチ選択手段16によって転送 スイッチ17を選択的し、転送スイッチ17を介して垂 直信号線52にアナログ映像信号を転送する。このとき 垂直走査回路18によって所定の走査線51を選択する ことで画素へ映像信号を書き込む。これにより画像表示 が可能となる。

【0090】液晶表示装置では、液晶の劣化を防ぐため イッチ群17にふり分けられる。さらに転送スイッチ選 40 に極性反転駆動を行うのが一般的である。この結果、結 晶に印加される電圧の振幅は液晶材料にもよるが、10 V程度以上と非常に高くなる。本実施形態においてはD /Aコンバータ12の出力は昇圧回路60によって昇圧 されるため、D/Aコンバータ12部分の電源電圧を小 さくでき、この部分で省電力化がはかれる。

> 【0091】図18及び図19は、図17に示す昇圧回 路60の例を示す等価回路図である。ここに示した例で は、昇圧回路はD/Aコンバータ12からの入力部が容 量58の容量結合でクランプ型のアンプ57になってお り、クランプレベルをスイッチ56で切り換えて任意に

設定できるようになっている。図18はクランプ型のア ンプ57のゲイン1の場合、図19は抵抗分割でアンプ 57のゲインを設定できる形式である。概念的には図2 0に示したようになる。D/Aコンバータの出力は反転 周期毎にビット反転させると図20(A)のような出力 になっている。しかし液晶に印加される信号は、対向電 極の電圧を中心に反転する必要がある。そこで、反転周 期に従ってVclmpを図20(B)のように変化させ、D /Aコンバータ12からの読み出しの前に、図20

(C) のように $\phi$ clmpをオン状態として、アンプ57の 基準となる電圧を変化させる。そうすることによって、 出力信号は図20(D)のようになる。従ってD/Aコ ンバータ12の電源電圧を大きくすることなく、反転駆 動が可能となる。ここに示した形態を採用するとD/A コンバータ12の低電圧化が図れる。

【0092】[第7実施形態]本発明の第7の実施形態 について、図面を参照しつつ説明する。ここでは、D/ Aコンバータの構成を工夫した例について説明する。

【0093】図21は、本実施形態のD/Aコンバータ の等価回路図である。図21においては、映像信号が4 ビットの場合を示している。本実施形態では、抵抗分割 によって5ケの基準電圧群を2種類作る回路と、極性反 転信号によって前記2種類の基準電圧群のうち1つを選 択する手段と、上位2ビットをデコードして5ケの基準 電圧のうち所定の2ケを選択する回路と、前記2ケの基 準電圧の間を抵抗で分割する回路と、下位2ビットをデ コードして前記抵抗で分割した電圧のうち1つを選択す る手段を有している。なお前記基準電圧群を2種類作る 回路は、図では基準電圧Vref 1~4の4つを入力して いるが、必ずしも基準電圧Vref 3. 4は入力する必要 はない(但し、中心の抵抗2ケがないときは必ず必 要)。

【0094】液晶表示装置では液晶材料の劣化を防ぐた めに反転駆動を行うのが一般的である。本実施形態で は、D/Aコンバータの基準電圧群を正転用と反転用の 2種類を発生させ、これを反転周期毎に切り替えること によって反転駆動を可能としている。つまりINVパル スを入力することによりスイッチを切り替え、基準電圧 を変化させる。このとき、抵抗分割の比は、液晶の電圧 一輝度特性を考慮し、設計者が任意に設定できる。出力 されるアナログ信号は、正転(INV=high)のと き基準電圧 Vref 4~ Vref 2、反転(INV=1o w) のとき基準電圧Vref 1~Vref 3のダイナミック レンジとなる。ここで正転(INV=high)のとき を考えると、まず5ケの基準電圧はVref 4~Vref 2 を抵抗で分割した電圧になる。映像信号の上位2ビット をデコードした信号によって、隣接する基準電圧4組の うち1組が選択される。さらに前記1組の基準電圧を抵 抗分割してつくる4つの電圧のうちの1つが、映像信号 の下位2ビットをデコードした信号によって選択され

る。以上によりディジタルーアナログ変換が可能であ る。本実施形態のD/Aコンバータのディジタルーアナ ログ変換特性は図22のように、入力のデジタルデータ に対してアナログ信号の出力は反転信号と非反転信号の 関係となる。

【0095】ところで半導体集積回路において抵抗素子 を構成する際、図23に示すような第1導電型のウエル 中に形成した第2導電型の拡散層を用いるのが一般的で ある。このpn接合に印加される逆バイアスによって、 10 接合部には空乏層が広がる。結果的にバイアス状態によ って空乏層幅が変化するため、抵抗値がバイアス依存を 持つことになる。本実施形態の場合、上位ビット即ち基 準電圧部のための抵抗素子は、図23(A)に示される ような高濃度(望ましくは $10^{19}$ cm $^{-3}$ 以上)の拡散層 によって形成し、下位ビットのための抵抗素子、は図2 3 (B) に示されるような低濃度の拡散層によって形成 することができる。一般的に空乏層幅は不純物濃度の逆 数の1/2乗に比例するので、上位ビットではバイアス 依存の少ない高精度の抵抗素子を用い、下位ビットには 20 バイアス依存はあっても小面積で高抵抗の素子を用いて いる事になる。下位ビットでは、各抵抗でのバイアスは 大きくは異ならないので、抵抗値も大きくは異ならな い。このため、低濃度の拡散層を用いた方が、小面積で 抵抗素子を構成できるため有利になる。一方上位ビット では各抵抗素子のバイアス状態は、各々大きく異なるた め、バイアス依存の少ない抵抗素子を用いる必要かあ

【0096】本実施形態のD/Aコンバータによれば、 D/Aコンバータの単調性が保証され、精度アップと回 路面積縮小が図れる。

【0097】[第8の実施形態]本発明の第8の実施形 態について図面を参照しつつ説明する。本実施形態に採 用されるD/Aコンバータに適用可能なバッファ回路を 工夫した形態について説明する。図24にバッファ回路 の構成を示す。このバッファ回路は2つの出力レンジの 違ったバッファ回路243、244、切り替えスイッ チ、バイアス回路から構成されている。

【0098】バッファ回路243,244では、一般的 に電源電圧範囲(VSS~VDD)の全レンジにわたる 出力レンジを得ることはできない。図25は図24の具 体的回路図であり、バッファ回路243では入力電圧が 電源電圧VDDに近づくにつれて、p型トランジスタ2 60,261のD-S間電圧が小さくなり動作が線形領 域に入る。この結果、トランジスタ260、261から 供給される電流は次第に小さくなるため、最大動作周波 数が次第に下がりはじめ、ついには出力可能な電圧の上 限に達する。一方VSSに近いレベルの入力に対して は、上記した制限はなく、VSS側にはより近い電圧出 力が可能である。従ってバッファ回路243は低電圧側 50 により広い出力レンジを持っている事になる。一方バッ

ファ回路244では、入力電圧がVSSに近づくにつれてn型トランジスタ267、268が線形領域に入る。このためバッファ回路243とは逆にバッファ回路244は高電圧側(VDD)により広い出力レンジを持つことになる。

【0099】液晶装置では液晶の劣化を防ぐために交流 駆動をするのが一般的である。そこで本実施形態では、 正転時と反転時で、出力レンジの異なる2つのバッファ 回路243,244を選択的に切り替え動作させる構成 をとることにより、低い電源電圧で、実質的により広い 出力レンジを得ることができる。

【0100】さらに詳しく図25を用いて説明する。2 40に入力された任意の電圧は、反転信号入力端子24 0に入力された反転信号、及び反転信号入力端子240 に入力された反転信号を反転する回路241から出力さ れた信号とによって選択された切り替えスイッチ251 ~254から選択されるバッファ回路から出力される。 ここで、切り替えスイッチ251, 252, 255, 2 56がP型トランジスタ、切り替えスイッチ253, 2 54. 257. 258がN型トランジスタである。 反転 信号入力端子240に入力された反転信号がHighの 時、切り替えスイッチ252, 253, 255, 25 6, 247は導通し、切り替えスイッチ251, 25 4. 257, 258, 246は非導通となる。この状態 になることにより、244のバッファ回路が出力し、2 43のバッファ回路はトランジスタ260, 261, 2 62, 263, 264のゲートがオフレベルに固定され ており完全にシャットダウンされる。

【0101】このように構成することにより、任意の入力電圧値によって、所望のバッファ回路を選択できる。 したがって、より広い出力レンジを得ることが出来る。 さらに、動作していないバッファ回路には電流が流れないので、消費電流の増加が妨げる。

【0102】[第9実施形態] ここでは、本発明の液晶 装置 (パネル) にマイクロレンズを設けた所謂単板式のフルカラー表示装置について説明する。

【0103】本出願人は、従来のマイクロレンズ付表示パネルを用いた投写型表示装置においてはR. G. Bのモザイク構造が目立ち、表示画像の品位が著しく低下するという点を解決するものとして、特願平9-92646号において、新規な表示パネルを提案した。特願平9-72646で提案した表示パネルは、第1. 第2. 第3の色画素の3つの色画素のうちの第1. 第2の色画素の組み合わせを第1方向に、該第1. 第3の色画素の組み合わせを第1方向と異なる第2方向に該第1の色画素を共有するように配置した画素ユニットを基板上に所定のピッチで2次元的に配列した画素ユニットアレイと、該第1方向と第2方向の2つの色画素のピッチを1ピッチとするマイクロレンズを複数個、該悲坂上の画素ユニットアレイ上に2次元的に配列したマイクロレンズ

アレイとを有している表示パネルである。

【0104】ここでは、特願平9-72646号において提案された表示パネルを、本発明の液晶装置及び表示装置に適用した例について説明する。

【0105】図26に本発明の液晶表示装置を用いた前 面及び背面投写型液晶表示装置光学系の構成図を示す。 本図はその上面図を表す図26(a)、正面図を表す図 26(b)、側面図を表す図26(c)から成ってい る。同図において、1301はマイクロレンズ付の液晶 装置を用いた表示パネル(液晶パネル)で表示した画像 情報をスクリーンに投射する投影レンズ、1302はマ イクロレンズ付液晶パネル、1303は例えばS偏光を 透過し、P偏光を反射する偏光ビームスプリッター(P BS)、1340はR(赤色光)反射ダイクロイックミ ラー、1341はB/G (青色&緑色光) 反射ダイクロ イックミラー、1342はB(青色光)反射ダイクロイ ックミラー、1343は全色光を反射する高反射ミラ 一、1350はフレネルレンズ、1351は凸レンズ (正レンズ)、1306はロッド型インテグレーター、 1307は楕円リフレクター、1308はメタルハライ ド、UHP等のアークランプである。

【0106】ここで、R(赤色光)反射ダイクロイックミラー1340、B/G(青色&緑色光)反射ダイクロイックミラー1341、B(青色光)反射ダイクロイックミラー1342はそれぞれ図27に示したような分光 反射特性を有している。そしてこれらのダイクロイックミラーは高反射ミラー1343とともに、図28の斜視 図に示したように3次元的に配置されており、後述するように白色照明光をRGBに色分解するとともに、液晶 のパネル1302に対して各原色光が、3次元的に異なる方向から該液晶パネル1302を照明するようにしている。

【0107】ここで、光束の進行過程に従って説明すると、まず光源のランプ1308からの出射光束は白色光であり、楕円リフレクター1307によりその前方のインテグレータ1306内を反射を繰り返しながら進行するにつれて光束の空間的強度分布が均一化される。そしてインテグレーター1306を出射した光束は凸レンズ1351とフレネルレンズ1350とにより、x軸一方向(図26(b)の正面図基準)に平行光束化され、まずB反射ダイクロ19イックミラー1342に至る。

【0108】このB反射ダイクロイックミラー1342ではB光(青色光)のみが反射され、z軸一方向つまり下側(図26(b)の正面図基準)にz軸に対して所定の角度でR反射ダイクロイックミラー1340に向かう。一方B光以外の色光(R/G光)はこのB反射ダイクロイックミラー1342を通過し、高反射ミラー1343により直角にz軸一方向(下側)に反射され、やはりR反射ダイクロイックミラー1340に向かう。

【0109】ここで、B反射ダイクロイックミラー1342と高反射ミラー1343は共に図26(a)の正面図を基にして言えば、インテグレーター1306からの光束(x軸一方向)をz軸一方向(下側)に反射するように配置しており、高反射ミラー1343はy軸方向を回転軸にx-y平面に対して丁度45°の傾きとなっている。それに対してB反射ダイクロイックミラー1342はやはりy軸方向を回転軸にx-y平面に対して、この45°よりも浅い角度に設定されている。

【0110】従って、高反射ミラー1343で反射され 10 されている。たR/G光はz軸一方向に直角に反射されるのに対し 【0117】 て、B反射ダイクロイックミラー1342で反射された B光はz軸に対して所定の角度(x-z面内チルト)で nm、図27下方向に向かう。ここで、B光とR/G光の液晶パネル 1302上の照明範囲を一致させるため、各色光の主光 7(c)に対象は液晶パネル1302上で交差するように、高反射ミ 340のカッラー1343とB反射ダイクロイックミラー1342の 色光はB/Cシフト量およびチルト量が選択されている。

【0111】次に、前述のように下方向(z軸一方向)に向かったR/G/B光はR反射ダイクロイックミラー 1340とB/G反射ダイクロイックミラー1341に向かうが、これらはB反射ダイクロイックミラー134 2と高反射ミラー1343の下側に位置し、まず、B/G反射ダイクロイックミラー1341はx軸を回転軸にx-z面に対して45°傾いて配置されており、R反射ダイクロイックミラー1340はやはりx軸方向を回転軸にx-z平面に対してこの45°よりも浅い角度に設定されている。

【0112】従って、これらに入射するR/G/B光のうち、まずB/G光はR反射ダイクロイックミラー1340を通過して、B/G反射ダイクロイックミラー1341により直角にy軸+方向に反射され、PBS1303を通じて偏光化された後、x-z面に水平に配置された液晶パネル1302を照明する。

【0113】このうちB光は、前述したように(図26 (a)、図26 (b)参照)、x軸に対して所定の角度 (x-z面内チルト)で進行しているため、B/G反射 ダイクロイックミラー1341による反射後は、y軸に 対して所定の角度 (x-y面内チルト)を維持し、その 角度を入射角 (x-y面方向)として該液晶パネル1302を照明する。

【0114】G光についてはB/G反射ダイクロイックミラー1341により直角に反射し、y軸+方向に進み、PBS1303を通じて偏光化された後、入射角0°つまり垂直に該液晶パネル1302を照明する。

【O115】また、R光については、前述のようにB/ の照明光R、G、Bをそれぞれ異なる角度から液晶パネ の反射ダイクロイックミラー1340によりR反射ダイクロイックミラー1340によりR反射ダイクロイックミラー1340にてy軸+方向に反射され ようにしている。これによって、カラーフィルターを不るが、O26 (O2) (側面図)に示したようにO2 朝に対 50 要とすると共に、高い光利用率を可能にした表示パネル

して所定の角度(y-z 面内チルト)でy 軸+方向に進み、PBS1303を通じて偏光化された後、該液晶パネル1302をこのy 軸に対する角度を入射角(y-z 面方向)として照明する。

28

【0116】また、前述と同様にRGB各色光の液晶パネル1302上の照明範囲を一致させるため、各色光の主光線は液晶パネル1302上で交差するように、B/G反射ダイクロイックミラー1341とR反射ダイクロイックミラー1340のシフト量およびチルト量が選択されている。

【0117】さらに、図27 (a)に示したようにB反射ダイクロイックミラー1341のカット波長は480 nm、図27 (b)に示したようにB/G反射ダイクロイックミラー1341のカット波長は570 nm、図27 (c)に示したようにR反射ダイクロイックミラー1340のカット波長は600 nmであるから、不要な橙色光はB/G反射ダイクロイックミラー1341を透過して捨てられる。これにより最適な色バランスを得ることができる。

【0118】そして後述するように液晶パネル1302 にて各R、G、B光は反射&偏光変調され、PBS13 03に戻り、PBS1303のPBS面1303aにて x軸+方向に反射する光束が画像光となり、投影レンズ 1301を通じて、スクリーン(不図示)に拡大投影される。

【0119】ところで、該液晶パネル1302を照明する各R、G、B光は入射角が異なるため、そこから反射されてくる各RGB光もその出射角を異にしているが、投影レンズ1301としてはこれらを全て取り込むに十30分な大きさのレンズ径及び開口のものを用いている。ただし、投影レンズ1301に入射する光束の傾きは、各色光がマイクロレンズを2回通過することにより平行化され、液晶パネル1302への入射光の傾きを維持している。

【0120】ところが図38に示したように従来例の透過型では、液晶パネルを出射した光東はマイクロレンズの集光作用分も加わってより大きく広がってしまうので、この光東を取り込むための投影レンズはさらに大きな開口数が求められ、大型で高価なレンズとなってい40 た。

【0121】図38において、1316は複数のマイクロレンズ1316aを所定のピッチで配列したマイクロレンズアレイ、1317は印加された電界強度により配向を変化する液晶層、1318はR(赤色)、G(緑色)、B(青色)の各画素である。赤、緑、青色の各色の照明光R、G、Bをそれぞれ異なる角度から液晶パネルレアに当て、マイクロレンズ1316aの集光作用により各色光がそれぞれ異なる色画素1318に入射するようにしている。これによって、カラーフィルターを不要とすると共に、高い光利用窓を可能にした表示パネル

を構成している。このような表示パネルを用いた投写型 表示装置は単板液晶パネルにても明るいフルカラー映像 を投写表示することができるようになっている。

【0122】しかしながら、このようなマイクロレンズ付の表示パネルを用いた投写型表示装置では、その投写表示画像のR. G. Bの各色画素1318がスクリーン上に拡大投影されたものになる。このため、図39に示したように、R. G. Bのモザイク構造が目立ってしまい、これが表示画像の品位を著しく低下してしまうという欠点を有していたのである。

【0123】これに対して、本実施形態では液晶パネル1302からの光束の広がりはこのように比較的小さくなるので、より小さな開口数の投影レンズでもスクリーン上で十分に明るい投影画像を得ることができ、より小型な安価な投影レンズを用いることが可能になる。且つ、R. G. Bのモザイク構造が目立つのが抑えられるのである。すなわち、図39に示す縦方向に同一色が並ぶストライプタイプの表示方式の例を本実施形態に用いることも可能であるが、後述するマイクロレンズを用いた液晶パネルの場合は好ましくない。

【0124】次に、ここで用いる本発明液晶パネル13 02について説明する。図29に該液晶パネル1302 の拡大断面模式図(図21のy-z面に対応)を示す。 図29は、本実施形態に係わる液晶パネル1302の特 徴部である水平方向回路については、他の実施形態で詳 しく説明したので、ここでは不図示としている。図29 において、1321はマイクロレンズ基板(ガラス基 板)、1322はマイクロレンズ、1323はシートガ ラス、1324は透明対向電極、1325は液晶層、1 326は画素電極、1327はアクティブマトリックス 駆動回路部、1328はシリコン半導体基板である。マ イクロレンズ1322はいわゆるイオン交換法によりガ ラス基板 (アルカリ系ガラス) 1321の表面上に形成 されており、画素電極1326のピッチの倍のピッチで 2次元的アレイ構造を有し、これによりマイクロレンズ アレイを成している。また、1252は周辺シール部で ある。ここで、本実施形態では、R, G, B画素が、1 パネルに集約されており、1画素のサイズは小さくな る。従って、開口率を上げることの重要性が大きく、集 光された光の範囲には、反射電極が存在していなければ ならず、第1~第5の実施形態で説明した構成が重要と なる。

【0125】液晶層1325は反射型に適応したいわゆるDAP、HAN等のECBモードのネマチック液晶を採用しており、不図示の配向層により所定の配向が維持されている。画素電極1326はAl(アルミ)から成り、反射鏡を兼ねており、表面性を良くして反射率を向上させるため、パターニング後の最終工程で前述したいわゆるCMP処理を施している。

【0126】アクティブマトリックス駆動回路部132

7はシリコン半導体基板1328上に設けられている。ここで、ドライバーとして水平方向回路と垂直方向回路を含むアクティブマトリックス駆動回路1327はR. G. Bの各原色映像信号を所定の各R. G. B画素に書き込むように構成されており、該各画素電極1326はカラーフィルターは有さないものの、前記アクティブマトリックス駆動回路1327にて書き込まれる原色映像信号により各R. G. B画素として区別され、後述する所定のR. G. B画素配列を形成している。

10 【0127】ここで、液晶パネル1302に対して照明するG光について説明する。前述したようにG光はPBS1303により偏光化されたのち該液晶パネル1302に対して垂直に入射する。この光線のうち1つのマイクロレンズ1322aに入射する光線例を図中の矢印G(in/out)に示す。

【0128】ここに図示されたように該G光線はマイクロレンズ1322により集光され、G画素電極1326g上を照明する。そしてA1より成る該画素電極1326gにより反射され、再び同じマイクロレンズ1322aを通じてパネル外に出射していく。このように液晶層1325を往復通過する際、該G光線(偏光)は画素電極1326gに印加される信号電圧により対向電極1324との間に形成される電界による液晶の動作により変調を受けて、該液晶パネルを出射し、PBS1303に戻る。ここで、その変調度合いによりPBS面1303aにて反射され、投影レンズ1301に向かう光量が変化し、各画素のいわゆる濃淡階調表示がなされることになる。

【0129】一方、上述したように図29中断面(y-z面)内の斜め方向から入射してくるR光については、やはりPBS1303により偏光されたのち、例えばマイクロレンズ1322bに入射するR光線に注目すると、図中の矢印R(in)で示したように、該マイクロレンズ1322bにより集光され、その真下よりも左側にシフトした位置にあるR画素電極1326r上を照明する。そして該画素電極1326rにより反射され、図示したように今度は隣(-z方向)のマイクロレンズ1322aを通じて、パネル外に出射していく(R(out))。

【0130】この際、該R光線(偏光)はやはり画素電極1326rに印加される信号電圧により対向電極1324との間に形成される画像信号に応じた電界による液晶の動作により変調を受けて、該液晶パネルを出射し、PBS1303に戻る。そして、その後のプロセスは前述のG光の場合と全く同じように、画像光を投影レンズ1301から投影される。

【0131】ところで、図29の描写ではG画素電極1326g上とR画素電極1326r上の各G光とR光の色光が1部重なり干渉しているようになっているが、こ れは模式的に液晶層1325の厚さを拡大誇張して描い

ているためであり、実際には該液晶層の厚さは $1\sim5\mu$ であり、シートガラス $1323050\sim100\mu$ に比べて非常に薄く、画素サイズに関係なくこのような干渉は起こらない。

【0132】次に、図30に本実施形態での色分解及び色合成の原理説明図を示す。ここで、図30(A)は液晶パネル1302の上面模式図、図30(B)、図30(C)はそれぞれ該液晶パネル上面模式図に対するA-A'(x方向)断面模式図、B-B'(z方向)断面模式図である。ここで、マイクロレンズ1322は、図30(A)の一点鎖線に示すように、G光を中心として両隣接する2色画素の半分ずつに対して1個が対応している。

【0133】このうち図30(C)はy-z断面を表す上記図29に対応するものであり、各マイクロレンズ1322に入射するG光とR光の入出射の様子を表している。これから判るように各G画素電極は各マイクロレンズの中心の真下に配置され、各R画素電極は各マイクロレンズ間境界の真下に配置されている。従ってR光の入射角はそのt a n  $\theta$  が画素ピッチ(B&R画素)とマイクロレンズ1322・画素電極1326間距離の比に等しくなるように設定するのが好ましい。

【0134】一方、図30(B)は該液晶パネル1302のx-y断面を表す図29に対応するものである。このx-y断面については、第3の色画素としてのB画素電極とG画素電極とが図30(C)と同様に交互に配置されており、やはり各G画素電極は各マイクロレンズ1322間の境界の真下に配置されている。

【0135】ところで該液晶パネル1322を照明する B光については、前述したようにPBS1303による 偏光化後、図28中断面(x-y面)の斜め方向から入射してくるため、R光の場合と全く同様に、各マイクロレンズ1322から入射したB光線は、図示したように B画素電極1326bにより反射され、入射したマイクロレンズ1322に対して、x方向に隣り合うマイクロレンズ1322から出射する。B画素電極1326b上の液晶による変調や液晶パネルからのB出射光の投影については、前述のG光およびR光と同様である。

【0136】また、各8画素電極1326 bは各マイクロレンズ間境界の真下に配置されており、8光の液晶パネルに対する入射角についても、8光と同様にその18 をマイクロレンズ・画素電極間距離の比に等しくなるように設定するのが好ましい。

【0137】ところで、本実施形態の液晶パネルでは以上述べたように各R、G、B画素の並びが2方向に対してはRGRGRG…の並びに、x方向に対してはBGBGBG…の並びとなっているが、図30(A)はその平

面的な並びを示している。このように各画素サイズは縦横共にマイクロレンズの約半分になっており、画素ピッチはx-z両方向ともにマイクロレンズのそれの半分になっている。また、G画素は平面的にもマイクロレンズ中心の真下に位置し、R画素はz方向のG画素間かつマイクロレンズ境界に位置し、B画素はx方向のG画素間かつマイクロレンズ境界に位置している。また、1つのマイクロレンズ単位の形状は矩形(画素の2倍サイズ)となっている。

32

【0138】図31に本液晶パネルの部分拡大上面図を示す。ここで図中の破線格子1329は1つの絵素を構成するR, G, B画素のまとまりを示している。尚、画素ユニットを基板上に2次元的に所定のピッチで配列して、画素ユニットアレイを構成している。つまり、図29のアクティブマトリックス駆動回路部1327により各R, G, B画素が駆動される際、破線格子1329で示されるR, G, B画素ユニットは同一画素位置に対応したR, G, B映像信号にて駆動される。

【0139】ここでR画素電極1326r、G画素電極1326g、B画素電極1326bから成る1つの絵素に注目してみると、まずR画素電極1326rは矢印r1で示されるようにマイクロレンズ1322bから前述したように斜めに入射するR光で照明され、そのR反射光は矢印r-2で示すようにマイクロレンズ1322aを通じて出射する。B画素電極1326bは矢印b1で示されるようにマイクロレンズ1322cから前述したように斜めに入射するB光で照明され、そのB反射光は矢印b2で示すようにやはりマイクロレンズ1322aを通じて出射する。

30 【0140】また、G画素電極1326gは正面後面矢印g12で示されるように、マイクロレンズ1322aから前述したように垂直(紙面奥へ向かう方向)に入射するG光で照明され、そのG反射光は同じマイクロレンズ1322aを通じて垂直に(紙面手前に出てくる方向)出射する。

【0141】このように、本液晶パネルにおいては、1 つの絵素を構成するR. G. B画素ユニットについて、各原色照明光の入射照明位置は異なるものの、それらの出射については、同じマイクロレンズ(この場合は13 22 a) から行われる。そしてこのことはその他の全ての絵素(R. G. B画素ユニット)についても成り立っている。

【0142】従って、図32には、本液晶パネル1302からの全出射光をPBS1303および投影レンズ1301を通じて、スクリーン1309に投写する概念図を示している。図32に示すように、液晶パネル1302を用いて、液晶パネル1302内のマイクロレンズ1322の位置又はその近傍がスクリーン1309上に結像投影されるように光学調整すると、その投影画像は図5034に示すようなマイクロレンズ1322の格子内に各

絵素を構成する該R、G、B画素ユニットからの出射光 が混色した状態つまり同画素混色した状態の絵素を構成 単位としたものとなる。本実施形態では、このように図 31に示す構成の表示パネル1302を用い、且つマイ クロレンズ1322の配置面又はその近傍がスクリーン 1309とほぼ共役関係となるようにして、スクリーン 1309面上でいわゆるR, G, Bモザイクが無い、質 感の高い良好なカラー画像表示が可能としている。

【0143】次に、本投写型液晶表示装置の駆動回路系 についてその全体ブロック図を図33に示す。ここで、 1310はパネルドライバーであり、R, G, B映像信 号を形成するとともに、対向電極1324の駆動信号、 各種タイミング信号等を形成している。1312はイン ターフェースであり、各種映像及び制御伝送信号を標準 映像信号等にデコードしている。また、1311はデコ ーダーであり、インターフェース1312からの標準映 像信号をR. G. B原色映像信号及び同期信号に、即ち 液晶パネル1302に対応した画像信号にデコード・変 換している。1314はバラストであり、楕円リフレク ター1307内のアークランプ1308を駆動点灯す る。1315は電源回路であり、各回路ブロックに対し て電源を供給している。1313は不図示の操作部を内 在したコントローラーであり、上記各回路ブロックを総 合的にコントロールするものである。

【0144】このように本投写型液晶表示装置は、その 駆動回路系は単板式プロジェクターとしては、ごく一般 的なものであり、特に駆動回路系に負担を掛けることな く、前述したようなR, G, Bモザイクの無い良好な質 感のカラー画像を表示することができるものである。

【0145】ところで図35に本実施形態における液晶 パネルの別形態の部分拡大上面図を示す。ここではマイ クロレンズ1322の中心真下位置にB画素電極132 6 bを配列し、それに対し左右方向にG画素1326g が交互に並ぶように、上下方向にR画素1326 r が交 互に並ぶように配列している。このように配列しても、 絵素を構成するR、G、B画素ユニットからの反射光が 1つの共通マイクロレンズから出射するように、B光を 垂直入射、R/G光を斜め入射(同角度異方向)とする ことにより、前実施形態と全く同様な効果を得ることが できる。また、さらにマイクロレンズ1322の中心真 40 下位置にR画素を配列しその他の色画素を左右または上 下方向にR画素に対してG、B画素を交互に並ぶように しても良い。

【0146】 [第10の実施形態] 図36に本発明に係 わる液晶パネルの第10の実施形態を示す。同図は本液 晶パネル1320の部分拡大断面図である。前記第9の 実施形態との相違点を述べると、まず対向ガラス基板と してシートガラス1323を用いており、マイクロレン ズ1220については、シートガラス1323上に熱可 塑性樹脂を用いたいわゆるリフロー法により形成してい 50 す回路図である。

34 る。さらに、非画素部にスペーサー柱1251を感光性 樹脂のフォトリソグラフィーにて形成している。

【0147】該液晶パネル1320の部分上面図を図3 7 (a) に示す。この図から判るようにスペーサー柱1 251は所定の画素のピッチでマイクロレンズ1220 の角隅部の非画素領域に形成されている。このスペーサ -柱1251を通るA-A′断面図を図37(b)に示 す。このスペーサー柱1251の形成密度については1 0~100画素ピッチでマトリックス状に設けるのが好 10 ましく、シートガラス1323の平面性と液晶の注入性 というスペーサー柱数に対して相反するパラメーターを 共に満足するように設定する必要がある。

【0148】また、本実施形態では金属膜パターンによ る遮光層1221を設けており、各マイクロレンズ境界 部分からの漏れ光の進入を防止している。これにより、 このような漏れ光による投影画像の彩度低下(各原色画 像光の混色による) やコントラスト低下が防止される。 従って本液晶パネル1320を用いて、第9の実施形態 の如き液晶パネルを備えた投写型表示装置を構成するこ とにより、さらにメリハリのある良好な画質が得られる ようになる。

## [0149]

【発明の効果】本発明の液晶装置によれば、外部駆動回 路の部品点数を削減でき、通常のアナログ入力の液晶装 置のように、デジタル画像信号を入力してD/Aコンバ ータを介して直接液晶素子をドライブすることで、映像 信号線の負荷を小さくすることができる。さらに、D/ Aコンバータ1ケ当たりの負荷も小さくできると共に液 晶画素への書き込み時間を長くすることができるので、 駆動周波数を低くすることが可能となる。これにより液 晶装置全体として低消費電力となり、且つ低消費電力ゆ えに高精細化が容易となる。これに加えてノイズの影響 さえ少なく、髙画質化が可能となる。

【0150】さらに、本発明に関わる投写型液晶表示装 置においては、マイクロレンズ付反射型液晶パネルとそ れぞれ異なる方向から各原色光を照明する光学系等を用 いて、1つの絵素を構成する1組のR, G. B画素から の液晶による変調後の反射光が同一のマイクロレンズを 通じて出射するようにしたことにより、R、G、Bモザ イクの無い質感の高い良好なカラー画像投写表示が可能

【0151】また、各画素からの光束はマイクロレンズ を2回通過してほぼ並行化されるので、マイクロレンズ のピッチを画素ピッチの倍サイズとできて製造的にコス トダウンとなり、また開口数の小さい安価な投影レンズ を用いてもスクリーン上で明るい投影画像を得ることが 可能になる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶パネルの駆動回路の1例を示

【図2】本発明による液晶パネルの前の映像信号並べ替 え回路の動作を示す模式図である。

【図3】本発明による液晶パネルの駆動回路の動作を示 すタイミング図である。

【図4】本発明による液晶パネルのD/Aコンバータの 周辺回路図と波形図である。

【図5】本発明による液晶パネルのD/Aコンバータの 周辺回路図と波形図である。

【図6】本発明による液晶装置の断面図である。

【図7】本発明による液晶装置の一例を示す概略的回路 図である。

【図8】本発明による液晶装置の入力部のディレイ回路 を含む回路図である。

【図9】本発明による液晶装置の液晶パネルの模式図で ある。

【図10】本発明による液晶装置の製造上のエッチング 処理の良否を判断するグラフである。

【図11】本発明による液晶装置を用いた液晶プロジェ クターの模式図である。

【図12】本発明による液晶プロジェクターの回路ブロ 20 拡大図である。 ック図である。

【図13】液晶装置の製造工程を示す模式図である。

【図14】液晶装置の製造工程を示す模式図である。

【図15】本発明の液晶パネルの駆動回路の1例を示す 回路図である。

【図16】本発明の液晶パネルの駆動回路の1例を示す 回路図である。

【図17】本発明の液晶パネルの駆動回路の1例を示す 回路図である。

【図18】本発明に適用可能なD/Aコンバータの出力 30 14, 15 バッファ を昇圧する昇圧回路の等価回路図である。

【図19】本発明に適用可能なD/Aコンバータの出力 を昇圧する昇圧回路の等価回路図である。

【図20】D/Aコンバータの出力を示す模式図であ る。

【図21】D/Aコンバータの等価回路図である。

【図22】D/Aコンバータの変換特性を示す模式図で ある。

【図23】抵抗素子の模式図である。

【図24】バッファ回路の模式図である。

【図25】バッファ回路の回路図である。

【図26】本発明の投写型表示装置の1例を示す模式図 である。

【図27】本発明の投写型表示装置に用いたダイクロイ ックミラーの分光反射特性図である。

【図28】本発明の投写型表示装置の色分解照明部の斜 視図である。

【図29】本発明の液晶パネルの1例を示す断面図であ

【図30】本発明の液晶パネルでの色分解色合成の原理 50 313 反射防止膜

説明図である。

【図31】本発明の液晶パネルの1例についての部分拡 大上面図である。

【図32】本発明の投写型表示装置の投影光学系を示す 模式図である。

【図33】本発明の投写型表示装置の駆動回路系を示す ブロック図である。

【図34】本発明の投写型表示装置の1例についてのス クリーン上の投影像の部分拡大図である。

10 【図35】本発明の液晶パネルの1例についての部分拡 大上面図である。

【図36】本発明の液晶パネルの1例を示す模式図であ

【図37】本発明の液晶パネルの1例についての部分拡 大上面図と部分拡大断面図である。

【図38】従来のマイクロレンズ付の透過型液晶パネル の部分拡大断面図である。

【図39】マイクロレンズ付の透過型液晶パネルを用い た従来の投写型表示装置でのスクリーン上投映像の部分

【図40】従来の液晶装置の1例を示す模式図である。

【図41】従来の液晶装置の1例を示す模式図である。

【符号の説明】

1 映像信号並び替え回路

2 水平走査回路

3 インバータ

4~7 OR回路 8~11 ラッチ回路

12, 13 D/Aコンバータ

16 転送SW選択回路

17 転送スイッチ

18 垂直走査回路

19 液晶画素

20 スイッチMOSトランジスタ

21 液晶

23 D/Aコンバータ

301 半導体基板

302, 302 p型及びn型ウェル

40 303, 303 ソース領域

304 ゲート領域

305. 305' ドレイン領域

306 LOCOS絶縁層

307 遮光層

308 PSG

309 プラズマSiN

310 ソース電極

311 連結電極

312 反射電極&画素電極

3 1 4	液晶層		387 ランプ温度検出
3 1 5	共通透明電極		388 制御ボード
	対向電極		389 フィルタ安全スイッチ
317,	317' 高濃度不純物領域		453 メインボード
3 1 9	表示領域		454 液晶パネルドライブヘッドボード
	反射防止膜		455, 456, 457 液晶装置
321,	322 シフトレジスタ		1220 マイクロレンズ(リフロー熱ダレ式)
323	n MOS		1251 スペーサー柱
3 2 4	pMOS		1252 周辺シール部
325	保持容量 /	0	1301 投影レンズ
	信号転送スイッチ		1302 マイクロレンズ付液晶パネル
	リセットスイッチ		1303 偏光ビームスプリッター(PBS)
	リセットパルス入力端子		1306 ロッド型インテグレータ
	リセット電源端子		1307 楕円リフレクター
3 3 1	映像信号入力端子		1308 アークランプ
3 3 2	昇圧レベルシフター		1309 スクリーン
3 4 2	パルスdelay用インバータ		1310 パネルドライバー
3 4 3	スイッチ		1311 デコーダー
3 4 4	出力		1312 インターフェース回路
3 4 5	容量 2	20	1314 バラスト(アークランプ点灯回路)
3 4 6	保護回路		1320 マイクロレンズ付液晶パネル
351	シール部		1321 マイクロレンズガラス基板
352	電極パッド		1322 マイクロレンズ(インデックス分布式)
353	クロックバッファー		1323 シートガラス
371	光源		1324 対向透明電極
372	集光レンズ		1325 液晶
373,	375 フレネルレンズ		1326 画素電極
374	色分解光学素子		1327 アクティブマトリックス駆動回路部
376	ミラー		1328 シリコン半導体基板
377	視野レンズ こ	30	1329 基本絵素単位
378	液晶装置		1340 R反射ダイクロイックミラー
379	絞り部		1341 B/G反射ダイクロイックミラー
380	投影レンズ		1342 B反射ダイクロイックミラー
3 8 1	スクリーン		1343 高反射ミラー
385	電源		1350 フレネルレンズ(第2コンデンサーレンズ)
386	プラグ		1351 第1コンデンサーレンズ
			F 177 1 0 3

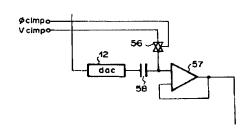
【図2】

# 元信号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 「画業ごとの信号に対応

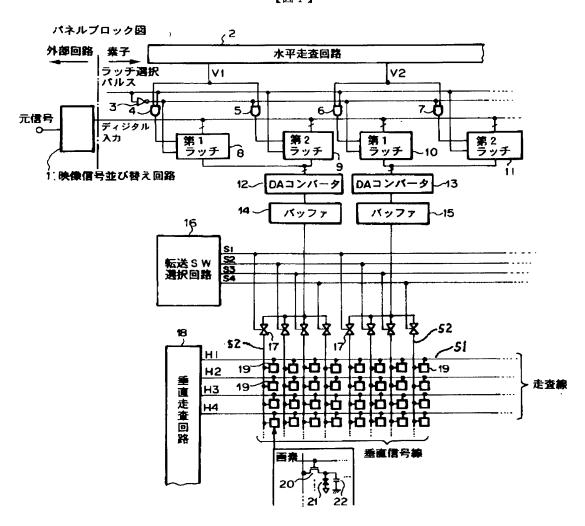
並び替え後 1 5 9 13 2 6 10 14 5 7 11 15 4 8 12 16

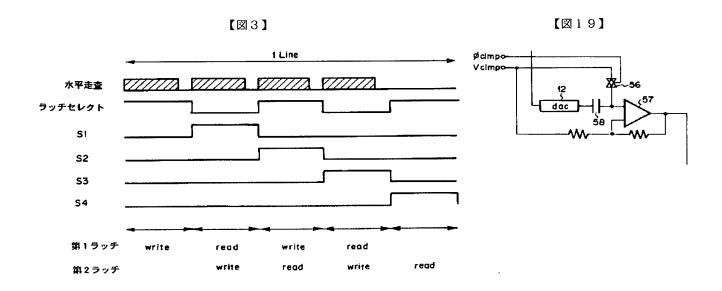
上記は1ケのD/Aコンパータに4本の垂直信号線が接続されていて、 水平方向の画案数が16の場合

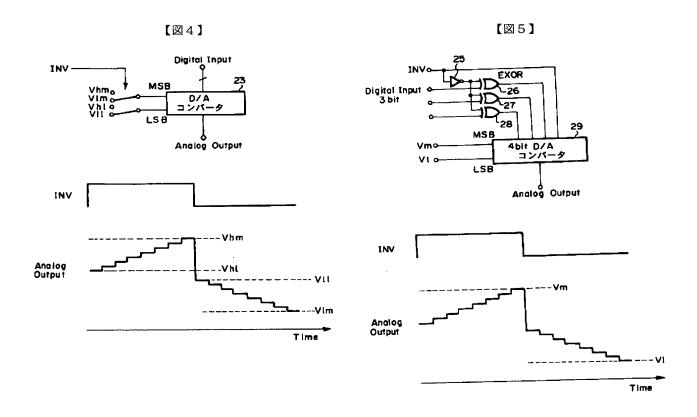
【図18】

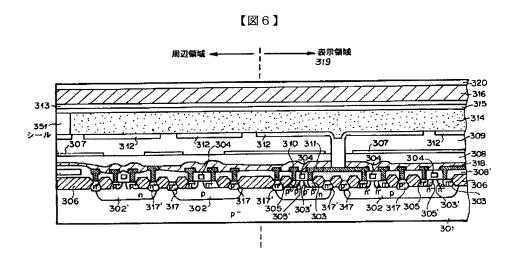


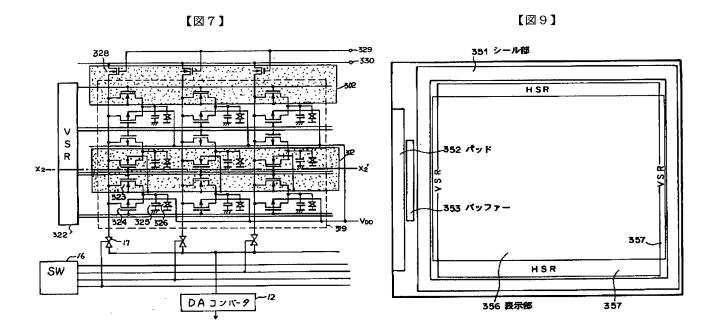
【図1】

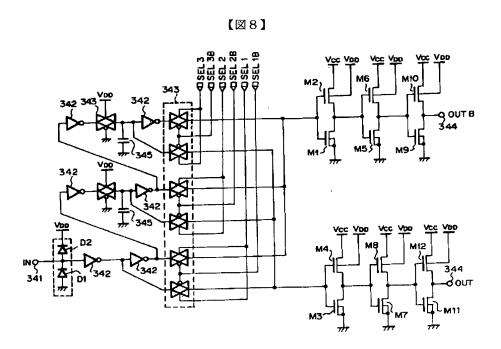


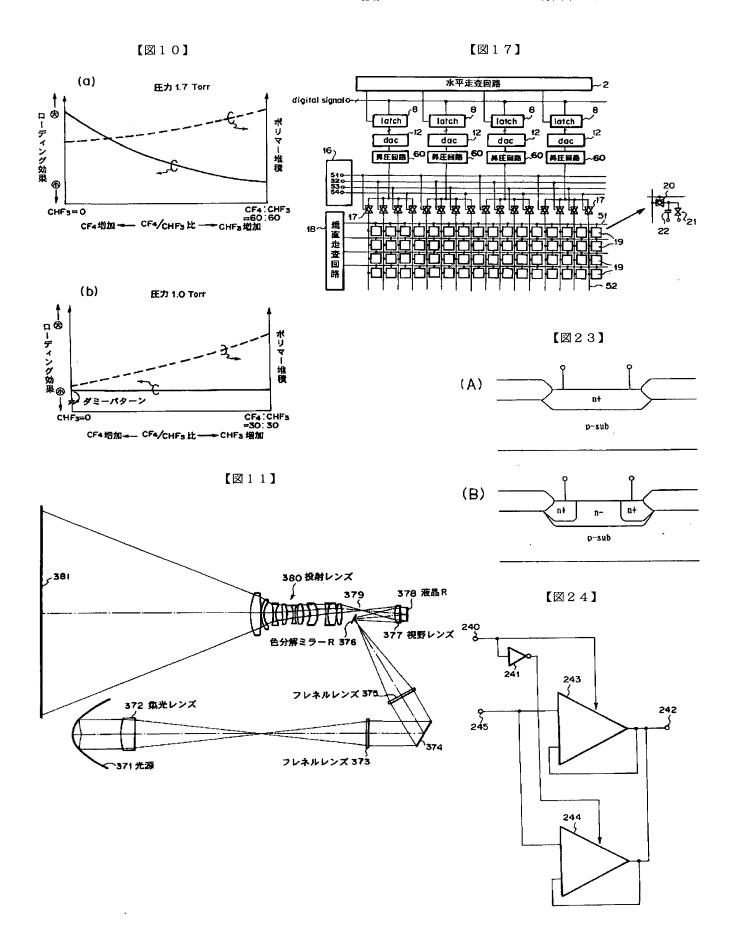




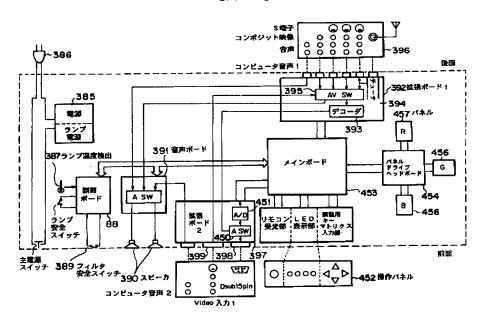




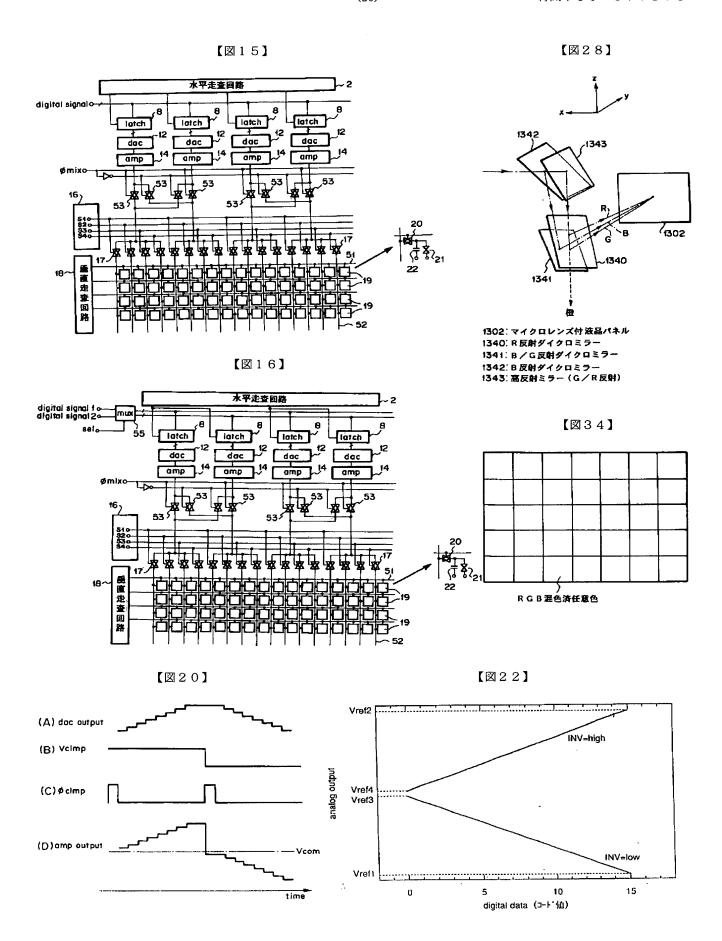




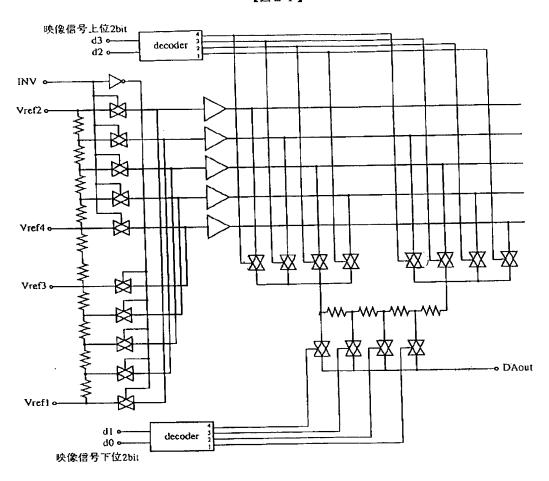
【図12】

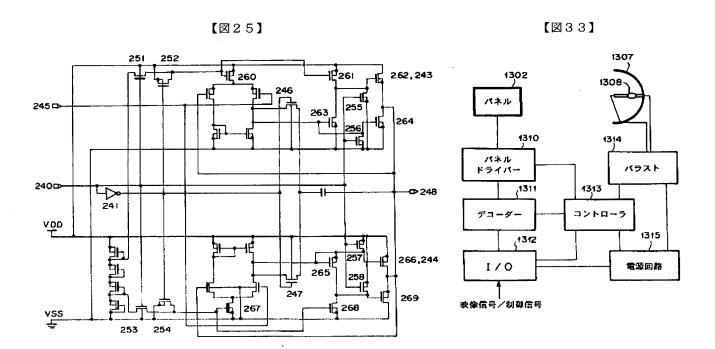


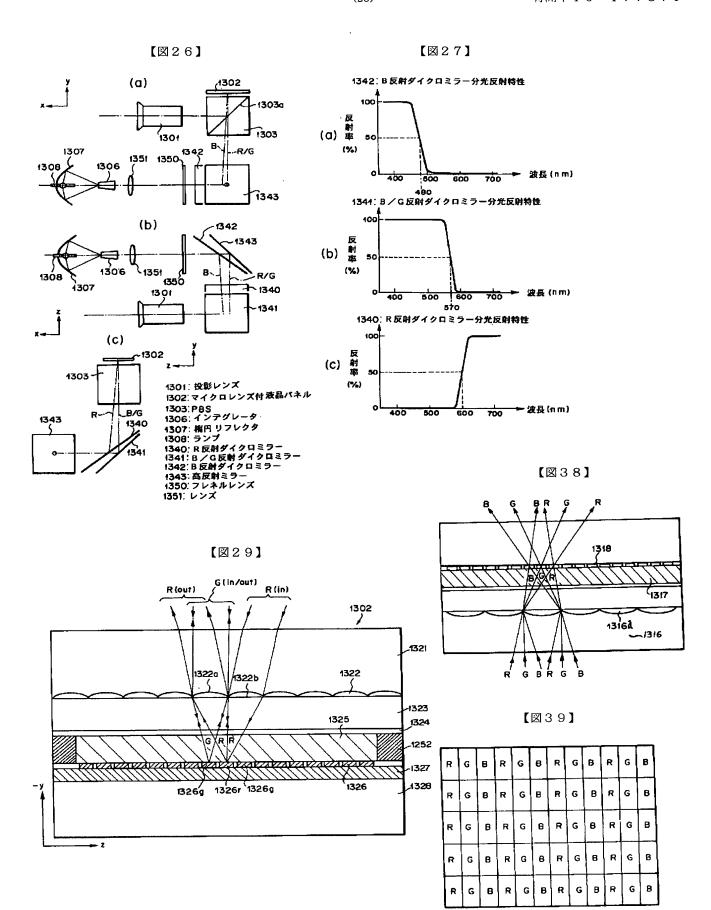
【図14】 【図13】 (f) (a) 204 203 202 (201 (b) (205 204 203 202 202 207 201 (g) 209 (C) 207,504,503,509 209 205 213 209 208 210 211 208 201 202 207 206 205 (d) 209 205 209 210 208 209 (h) 221 220 223 222 222 214 221 (e) 207 206 207 203 202 201 206 204 207 203 201 202



【図21】



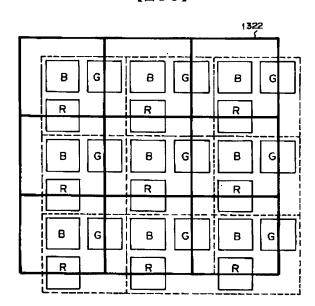


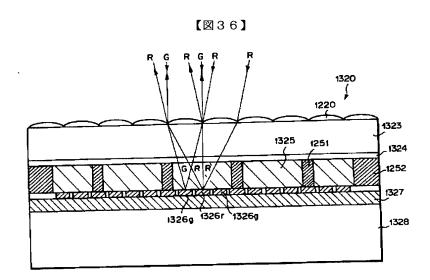


【図30】 【図31】 1329 (C) B – B' 断面 (A) 13226 R R G В G В R G В R (B) a – a' 虧面 G 1322マイクロレンズ 1325 液晶

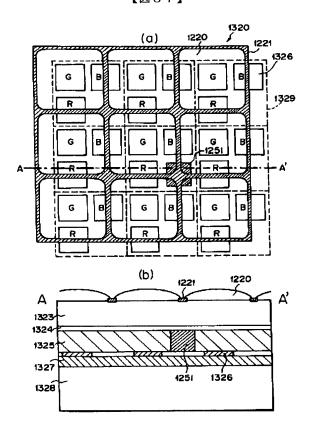
[図32]

【図35】

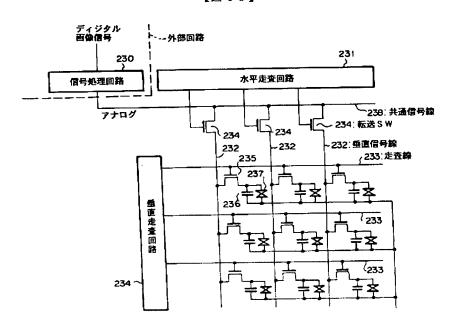




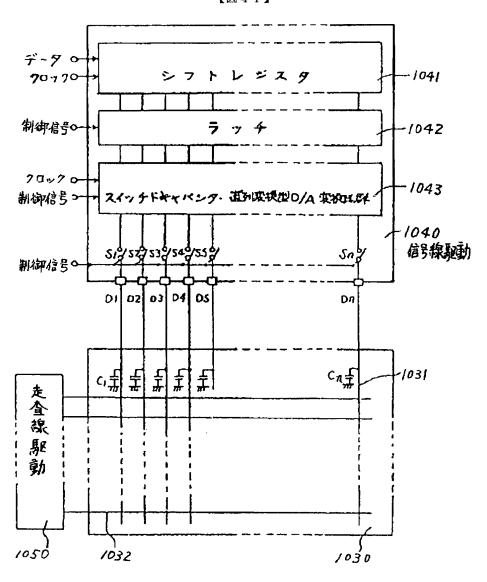
【図37】



【図40】



【図41】



フロントページの続き

(72)発明者 榑松 克巳

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

(72) 発明者 小山 理

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内